

(19) 日本国特許庁 (JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02010/047011

発行日 平成24年3月15日 (2012. 3. 15)

(43) 国際公開日 平成22年4月29日 (2010. 4. 29)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>G02F 1/137 (2006.01)</b>	G O 2 F 1/137 5 2 5	2 H 0 9 0
<b>C08F 2/44 (2006.01)</b>	C O 8 F 2/44 C	4 J 0 1 1
<b>C08F 20/00 (2006.01)</b>	C O 8 F 20/00	4 J 0 2 6
<b>C08G 73/10 (2006.01)</b>	C O 8 G 73/10	4 J 0 4 3
<b>C08F 283/04 (2006.01)</b>	C O 8 F 283/04	4 J 1 0 0
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 64 頁)		

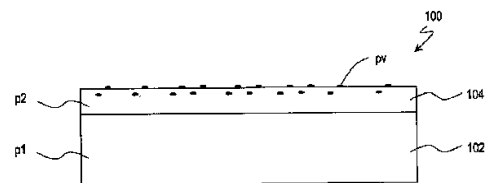
出願番号	特願2010-534653 (P2010-534653)	(71) 出願人	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番22号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2009/002862	(74) 代理人	100101683 弁理士 奥田 誠司
(22) 国際出願日	平成21年6月23日 (2009. 6. 23)	(74) 代理人	100155000 弁理士 喜多 修市
(31) 優先権主張番号	特願2008-271376 (P2008-271376)	(74) 代理人	100139930 弁理士 山下 亮司
(32) 優先日	平成20年10月21日 (2008. 10. 21)	(74) 代理人	100125922 弁理士 三宅 章子
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	水崎 真伸 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番22号 シャープ株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 配向膜、配向膜材料および配向膜を有する液晶表示装置ならびにその形成方法

## (57) 【要約】

本発明による配向膜材料は、第1ポリイミド (p1) の前駆体と、第2ポリイミド (p2) およびその前駆体と、ビニル系モノマーを含む。ビニル系モノマーは、一般式 (1)  $P1-A1-(Z1-A2)_n-P2$  (一般式 (1) において、P1およびP2は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、A1およびA2は、独立に、1, 4-フェニレン、1, 4-シクロヘキサンまたは2, 5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2, 6-ジイルまたはアントラセン-2, 7-ジイルを表し、A1およびA2の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、Z1は  $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-O-$ 、 $-CONH-$  基または単結合であり、nは0または1である) で表される。

【図1】



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

第 1 ポリイミドの前駆体と、

前記第 1 ポリイミドとは異なる第 2 ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方と、  
ビニル基を有するビニル系モノマーと

を含有する、配向膜材料であって、

前記ビニル系モノマーは、一般式 (1)  $P1 - A1 - (Z1 - A2)_n - P2$  (一般式 (1) において、 $P1$  および  $P2$  は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $A1$  および  $A2$  は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは 2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、 $A1$  および  $A2$  の少なくとも一方は少なくとも 1 個のフッ素基で置換されており、 $Z1$  は  $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-O-$ 、 $-CONH-$  基または単結合であり、 $n$  は 0 または 1 である) で表される、配向膜材料。

10

## 【請求項 2】

前記ビニル系モノマーは対称な構造を有する 2 官能モノマーである、請求項 1 に記載の配向膜材料。

## 【請求項 3】

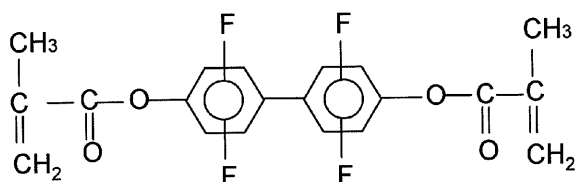
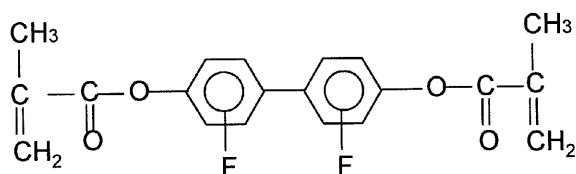
前記ビニル系モノマーはジメタクリレートモノマーである、請求項 1 または 2 に記載の配向膜材料。

## 【請求項 4】

前記ビニル系モノマーは構造式 (1a)

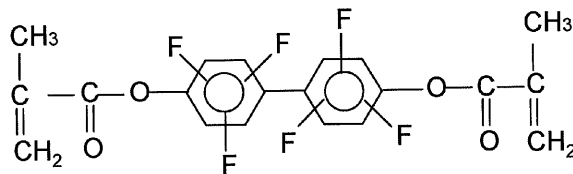
20

## 【化 1】



(1a)

30



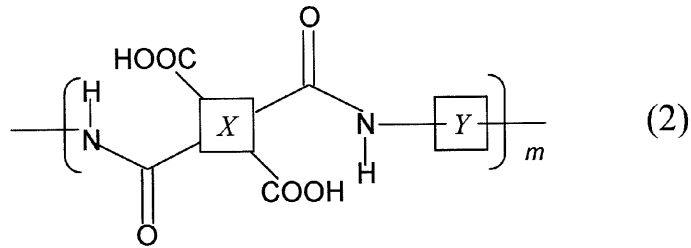
40

で表される、請求項 1 から 3 のいずれかに記載の配向膜材料。

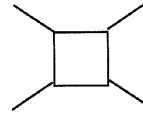
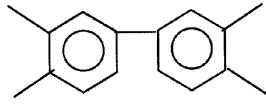
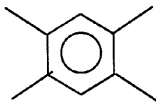
## 【請求項 5】

前記第 1 ポリイミドの前駆体は一般式 (2)

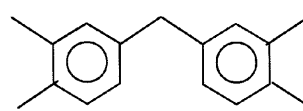
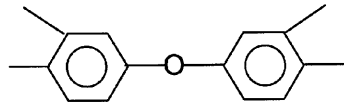
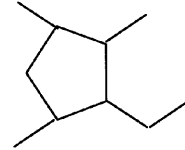
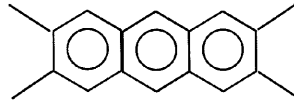
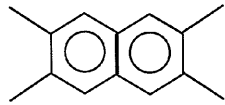
## 【化 2】



X

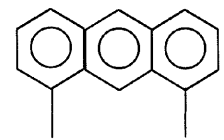
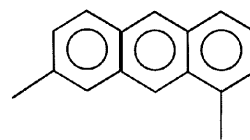
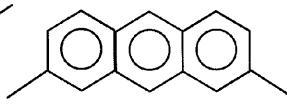
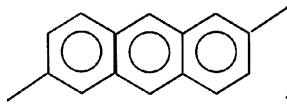
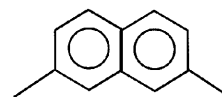
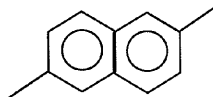
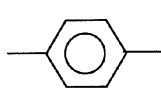
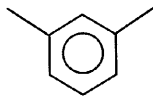


10

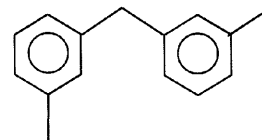
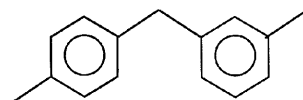
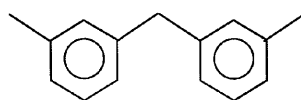
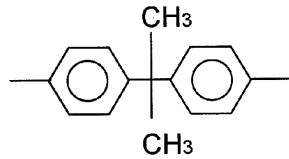
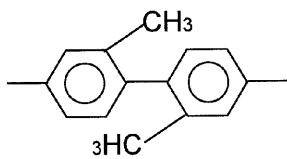
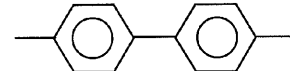
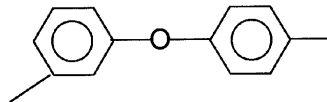
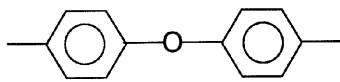


20

Y



30



40

で表される、請求項 1 から 4 のいずれかに記載の配向膜材料。

## 【請求項 6】

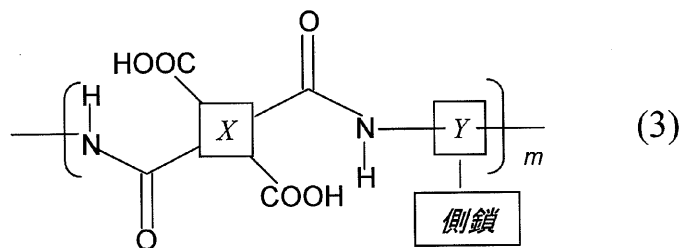
前記第 1 ポリイミドの前駆体の側鎖は垂直配向性基を有しない、請求項 1 から 5 のいずれかに記載の配向膜材料。

## 【請求項 7】

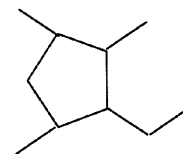
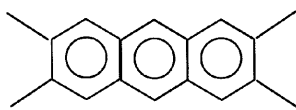
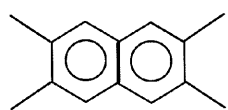
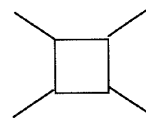
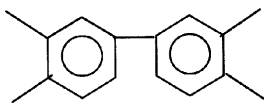
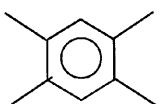
前記第 2 ポリイミドの前駆体は一般式 (3)

50

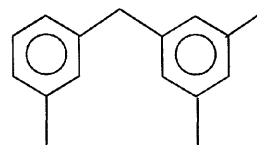
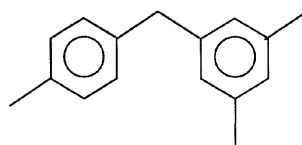
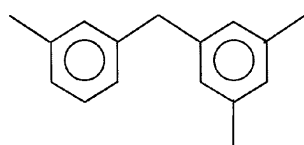
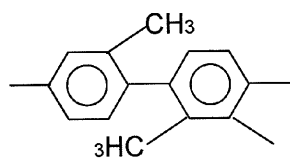
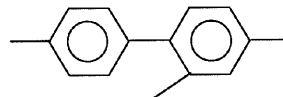
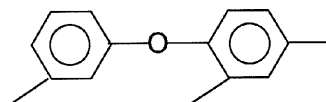
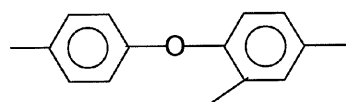
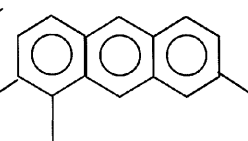
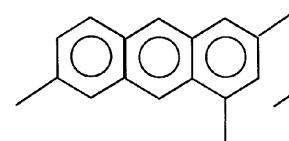
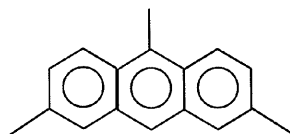
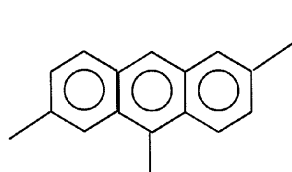
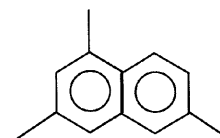
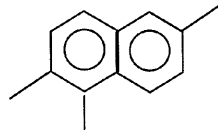
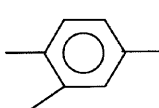
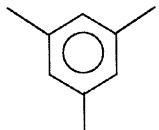
## 【化 3】



X



Y



10

20

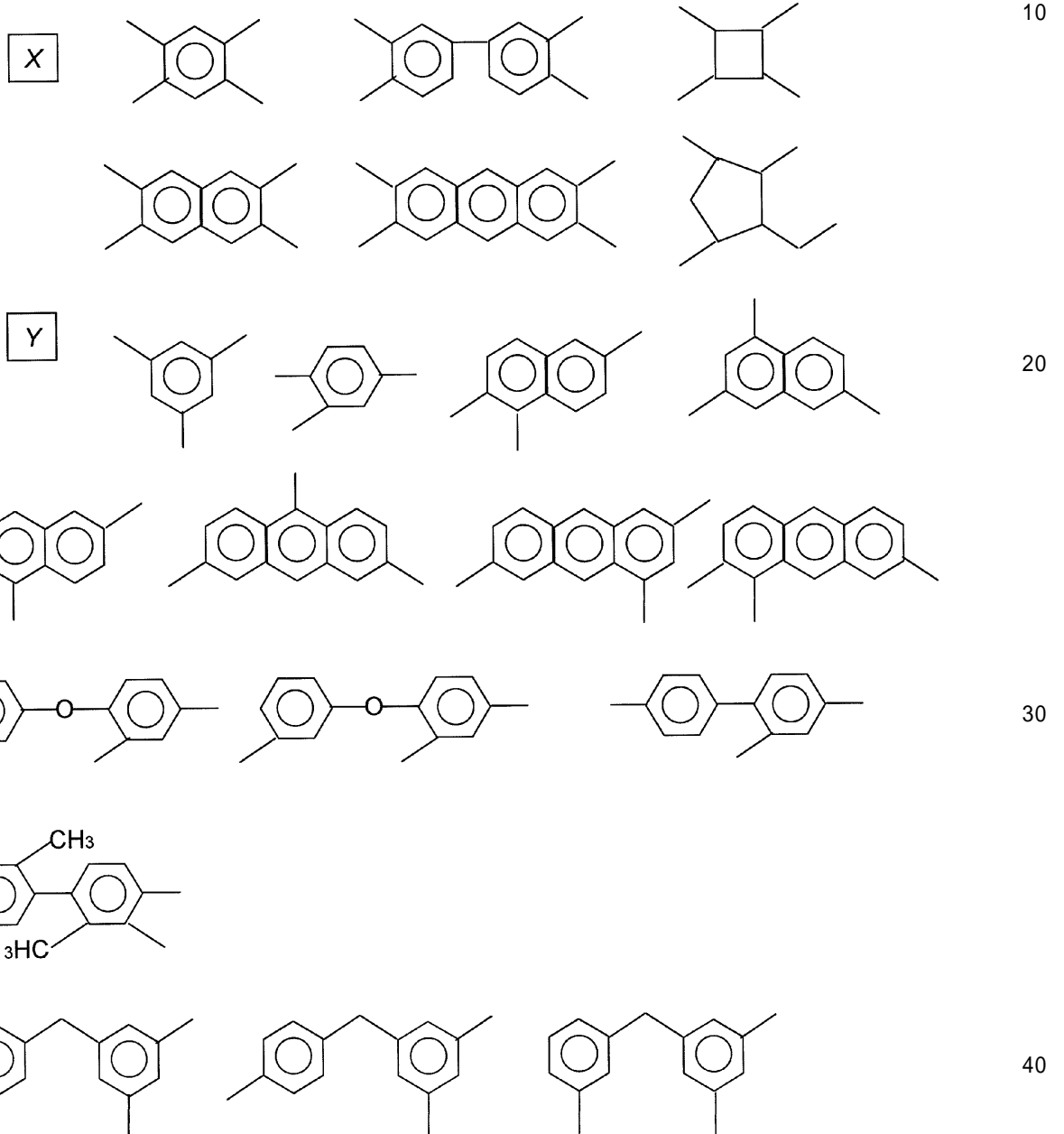
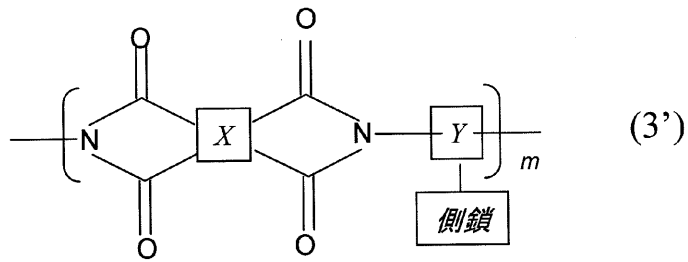
30

40

で表され、

前記第 2 ポリイミドは一般式 ( 3 ' )

## 【化 4】



で表される、請求項 1 から 6 のいずれかに記載の配向膜材料。

## 【請求項 8】

前記第 2 ポリイミドはフッ素基を含む側鎖を有する、請求項 1 から 7 のいずれかに記載の配向膜材料。

## 【請求項 9】

前記第 2 ポリイミドは光反応性官能基を有する、請求項 1 から 8 のいずれかに記載の配向膜材料。

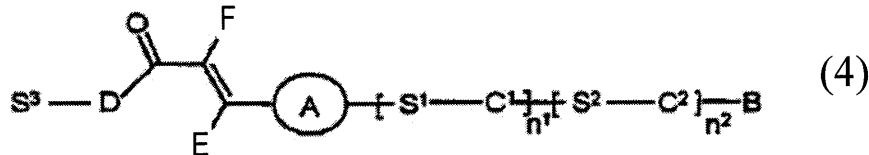
## 【請求項 10】

前記光反応性官能基は、シンナメート基、カルコン基、トラン基、クマリン基およびアゾベンゼン基からなる群から選択された少なくとも一つである、請求項 9 に記載の配向膜材料。

## 【請求項 11】

前記第 2 ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方は一般式 (4)

## 【化 5】



10

で表される側鎖を有する、請求項 9 または 10 に記載の配向膜材料。

## 【請求項 12】

前記第 2 ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方は垂直配向性基を含む側鎖を有する、請求項 1 から 8 のいずれかに記載の配向膜材料。

## 【請求項 13】

前記配向膜材料に対する前記ビニル系モノマーの濃度は 2 wt % 以上 20 wt % 以下である、請求項 1 から 12 のいずれかに記載の配向膜材料。

20

## 【請求項 14】

第 1 ポリイミドと、  
前記第 1 ポリイミドとは異なる第 2 ポリイミドと、  
ビニル系モノマーの重合したポリビニル化合物と  
を備える、配向膜であって、

前記ビニル系モノマーは、一般式 (1)  $\text{P}1 - \text{A}1 - (\text{Z}1 - \text{A}2)_n - \text{P}2$  (一般式 (1) において、 $\text{P}1$  および  $\text{P}2$  は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは 2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  の少なくとも一方は少なくとも 1 個のフッ素基で置換されており、 $\text{Z}1$  は  $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$  基または単結合であり、 $n$  は 0 または 1 である) で表される、配向膜。

30

## 【請求項 15】

前記配向膜は、前記第 1 ポリイミドを含む第 1 配向層と、前記第 2 ポリイミドを含む第 2 配向層とを有している、請求項 14 に記載の配向膜。

## 【請求項 16】

前記ポリビニル化合物は、前記第 2 配向層内および前記第 2 配向層の表面に存在する、請求項 15 に記載の配向膜。

## 【請求項 17】

画素電極を有するアクティブマトリクス基板と、  
対向電極を有する対向基板と、  
前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に設けられた垂直配向型の液晶層と  
を備える、液晶表示装置であって、

40

前記アクティブマトリクス基板および前記対向基板の少なくとも一方は前記液晶層側に設けられた配向膜をさらに有しており、

前記配向膜は、

第 1 ポリイミドと、

前記第 1 ポリイミドとは異なる第 2 ポリイミドと、

50

ビニル系モノマーの重合したポリビニル化合物とを有しており、

前記ビニル系モノマーは、一般式(1)  $P1-A1-(Z1-A2)_n-P2$  (一般式(1)において、 $P1$ および $P2$ は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $A1$ および $A2$ は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、 $A1$ および $A2$ の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、 $Z1$ は $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-O-$ 、 $-CONH-$ 基または単結合であり、 $n$ は0または1である)で表される、液晶表示装置

10

【請求項18】

前記配向膜は、前記第1ポリイミドを含む第1配向層と、前記第2ポリイミドを含む第2配向層とを有している、請求項17に記載の液晶表示装置。

【請求項19】

前記第2配向層は前記第1配向層よりも前記液晶層側に設けられており、

前記ポリビニル化合物は前記第2配向層内および前記第2配向層の表面に存在する、請求項18に記載の液晶表示装置。

【請求項20】

前記配向膜は、電圧無印加時に前記液晶層の液晶分子が前記配向膜の主面の法線方向から傾くように前記液晶分子を規定する、請求項17から19のいずれかに記載の液晶表示装置。

20

【請求項21】

前記液晶表示装置は複数の画素を有しており、

前記液晶層は、前記複数の画素のそれぞれに対して、基準配向方位の互いに異なる複数の液晶ドメインを有している、請求項17から20のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項22】

前記複数の液晶ドメインは4つの液晶ドメインである、請求項21に記載の液晶表示装置。

【請求項23】

第1ポリイミドの前駆体と、前記第1ポリイミドとは異なる第2ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方と、ビニル系モノマーとを含有する配向膜材料を用意する工程と、

30

前記配向膜材料を塗布する工程と、

前記配向膜材料を加熱する工程であって、前記第1ポリイミドの前駆体の少なくとも一部を前記第1ポリイミドにイミド化し、前記ビニル系モノマーを重合してポリビニル化合物を形成する工程と

を包含する、配向膜の形成方法。

【請求項24】

前記配向膜材料を用意する工程において、前記ビニル系モノマーは、一般式(1)  $P1-A1-(Z1-A2)_n-P2$  (一般式(1)において、 $P1$ および $P2$ は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $A1$ および $A2$ は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、 $A1$ および $A2$ の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、 $Z1$ は $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-O-$ 、 $-CONH-$ 基または単結合であり、 $n$ は0または1である)で表される、請求項23に記載の配向膜の形成方法。

40

【請求項25】

前記加熱する工程の後、前記第2ポリイミドのイミド化率は前記第1ポリイミドのイミド化率よりも大きい、請求項23または24に記載の配向膜の形成方法。

【請求項26】

50

前記配向膜材料を塗布する工程は、前記配向膜材料の塗布を印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で行う工程を含む、請求項 23 から 25 のいずれかに記載の配向膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、配向膜、配向膜材料および上記配向膜を有する液晶表示装置ならびにその形成方法に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置は、携帯電話の表示部等の小型の表示装置だけでなく大型テレビジョンとしても利用されている。従来しばしば用いられた TN (Twisted Nematic) モードの液晶表示装置は比較的狭い視野角を有していたが、近年、IPS (In-Plane Switching) モードおよび VA (Vertical Alignment) モードといった広視野角の液晶表示装置が作製されている。そのような広視野角のモードの中でも、VA モードは高コントラスト比を実現できるため、多くの液晶表示装置に採用されている。

【0003】

液晶表示装置には、その近傍の液晶分子の配向方向を規定する配向膜を有しており、VA モードの液晶表示装置において、配向膜は、液晶分子をその主面に略垂直に配向する。一般的な配向膜は、耐熱性、耐溶媒性および吸湿性等の点で利点を有するポリイミドから形成されている。

【0004】

VA モードの一種として、1つの画素領域に複数の液晶ドメインを形成する MVA (Multi-domain Vertical Alignment) モードが知られている。MVA モードの液晶表示装置には、垂直配向型液晶層を挟んで対向する一対の基板のうちの少なくとも一方の液晶層側に配向規制構造が設けられている。配向規制構造は、例えば、電極に設けられた線状のスリット（開口部）またはリブ（突起構造）である。配向規制構造により、液晶層の一方または両側から配向規制力が付与され、配向方向の異なる複数の液晶ドメイン（典型的には4つの液晶ドメイン）が形成され、視野角特性の改善が図られている。

【0005】

また、VA モードの別の一種として、CPA (Continuous Pinwheel Alignment) モードも知られている。一般的な CPA モードの液晶表示装置では対称性の高い形状を有する画素電極が設けられるとともに液晶ドメインの中心に対応して対向電極に突起物が設けられている。この突起物はリベットとも呼ばれる。電圧を印加すると、対向電極と対称性の高い画素電極とによって形成される斜め電界にしたがって液晶分子は放射形状に傾斜配向する。また、リベットの傾斜側面の配向規制力によって液晶分子の傾斜配向が安定化される。このように、1画素内の液晶分子が放射形状に配向することにより、視野角特性の改善が行われている。

【0006】

配向膜によって液晶分子のプレチルト方向を規定している TN モードの液晶表示装置とは異なり、MVA モードの液晶表示装置では、線状のスリットやリブによって配向規制力が液晶分子に付与されているため、画素領域内の液晶分子に対する配向規制力はスリットやリブからの距離に応じて異なり、画素内の液晶分子の応答速度に差が生じる。同様に、CPA モードでも画素内の液晶分子の応答速度に差が生じ、また、画素電極のサイズが大きくなるほど、応答速度の差が顕著になる。さらに、VA モードの液晶表示装置においてスリット、リブまたはリベットが設けられている領域の光の透過率が低いので、高輝度の実現が困難である。

【0007】

10

20

30

40

50

上述の問題を回避するために、V A モードの液晶表示装置についても、電圧無印加時に配向膜の主面の法線方向から傾くように液晶分子に配向規制力を付与する配向膜を用いることが知られている（例えば、特許文献 1、2 参照）。

【0008】

特許文献 1 に開示されている液晶表示装置には、配向膜に対してラビング等の配向処理が行われており、配向膜により、液晶分子が電圧無印加時においてもその主面の法線方向から傾いて配向するように規定され、これにより、応答速度の向上が実現される。さらに、1 画素内の液晶分子が対称的に配向するように配向膜が液晶分子のプレチルト方位を規定することにより、視野角特性の改善が行われる。特許文献 1 に開示されている液晶表示装置では、液晶層には、第 1 配向膜の 2 つの配向領域と第 2 配向膜の 2 つの配向領域との組み合わせに応じて 4 つの液晶ドメインが形成されており、これにより、広視野角化が図られている。

10

【0009】

また、特許文献 2 に開示されている配向膜は光反応性官能基を側鎖に有する感光性材料から形成されており、この配向膜に対して斜めから光を照射することにより、電圧無印加状態において液晶分子が配向膜の主面の法線方向から傾くようにプレチルトが付与される。このような光配向処理によってプレチルトが付与される配向膜は光配向膜とも呼ばれる。特許文献 2 に開示されている光配向膜は、光反応性官能基の結合構造を含む配向膜材料を用いることによってプレチルト角のばらつきが 1 ° 以下に制御されている。

20

【0010】

1 つのポリマーを用いて形成された配向膜では十分な特性が得られないことがある。このため、2 つの異なるポリマーから配向膜を形成することが検討されている（特許文献 3 および非特許文献 1 参照）。

【0011】

特許文献 3 に開示されている配向膜は、分子量および / または極性の大きい第 1 のポリマーから形成された主体層と、分子量および / または極性の小さい第 2 のポリマーから形成された表面層とを有している。第 1 のポリマーとして、内部 D C バイアス電圧がほとんど生じない芳香族を含む材料（例えば、日産化学工業株式会社製 S E 7 6 9 0）が用いられている。また、第 2 のポリマーは紫外線照射に対するプレチルト角の変化の大きい材料であり、シクロブタン系のポリマーの材料である。特許文献 3 では、第 2 のポリマーとして日産化学工業製 S E 7 2 1 0 が用いられている。

30

【0012】

また、非特許文献 1 には、ポリアミック酸を主成分とする下側層と、ポリイミドを主成分とする上側層とを含む配向膜が開示されている。非特許文献 1 では、プリベークの温度および時間を適切に設定することにより、上側層および下側層の二層分離が行われている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0013】

【特許文献 1】特開平 1 1 - 3 5 2 4 8 6 号公報

40

【特許文献 2】国際公開第 2 0 0 6 / 1 2 1 2 2 0 号パンフレット

【特許文献 3】特開平 8 - 3 3 4 7 7 1 号公報

【非特許文献】

【0014】

【非特許文献 1】ム - スン クウァク ( M u - S u n K w a k ) ら、「オブザベーション オブ ハイブリッド タイプ アラインメント フィルム イン ティエフティー - エルシーディ ( O b s e r v a t i o n o f H y b r i d T y p e A l i g n m e n t F i l m i n T F T - L C D )」、2 0 0 7 年日本液晶学会討論会講演予稿集、2 0 0 7 年 9 月、P A 0 3、p 1 3 8

【発明の概要】

50

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0015】

一般に、液晶表示装置では同一のパターンを長時間表示し続けると、表示を切り替えても前のパターンが残ってしまうことがある。このような現象は焼き付きとも呼ばれている。例えば、画面の一部の領域に白を、別の領域に黒を長時間表示した後で、液晶パネル全体に同じ中間階調を表示すると、前に黒を表示していた領域よりも前に白を表示していた領域がわずかに明るく見えることがある。

## 【0016】

このような焼き付きの原因の1つは電荷の蓄積による。黒を表示していた領域に蓄積された電荷量は、白を表示していた領域に蓄積された電荷量とは異なり、液晶中の不純物イオンが配向膜と液晶層の界面に蓄積することに起因して電界が発生する。このため、全体を同じ階調に切り替えた場合、白および黒を表示していた領域の各々の液晶層に異なる電圧が印加されて焼き付きとして認識される。

10

## 【0017】

なお、このような電荷の蓄積に起因する焼き付きは、各画素に極性の反転した電圧を印加することにより、ある程度抑制可能である。このため、電荷の蓄積に起因する焼き付きはDC焼き付きとも呼ばれている。また、DC焼き付きを抑制するために極性の反転した電圧を印加する駆動は極性反転駆動とも呼ばれている。なお、実際には、極性反転駆動を行っても、極性の完全に対称な電圧を印加することは困難であり、発生した焼き付きがフリッカーとして認識されることもある。

20

## 【0018】

また、プレチルト角が微小に変化しても焼き付きが生じる。プレチルト角が変化するとV-T特性に影響が生じるため、同じ電圧を印加しても透過率が変化してしまう。白表示時の印加電圧は黒表示時の印加電圧とは異なるため、印加電圧に応じてチルト角の変化量が異なり、その後、全体を同じ階調に切り替えた場合、チルト角の変化に起因して焼き付きが認識されることがある。このような焼き付きは極性反転駆動を行っても抑制できず、AC焼き付きとも呼ばれている。

## 【0019】

本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、プレチルト角の変化に起因する焼き付きを抑制する配向膜、上記配向膜を形成するための配向膜材料、および、上記配向膜を有する液晶表示装置、ならびに、その形成方法を提供することである。

30

## 【課題を解決するための手段】

## 【0020】

本発明による配向膜材料は、第1ポリイミドの前駆体と、前記第1ポリイミドとは異なる第2ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方と、ビニル基を有するビニル系モノマーとを含有する、配向膜材料であって、前記ビニル系モノマーは、一般式(1)P1-A1-(Z1-A2)n-P2(一般式(1)において、P1およびP2は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、A1およびA2は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、A1およびA2の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、Z1は-COO-、-OCO-、-O-、-CONH-基または単結合であり、nは0または1である)で表される。

40

## 【0021】

ある実施形態において、前記ビニル系モノマーは対称な構造を有する2官能モノマーである。

## 【0022】

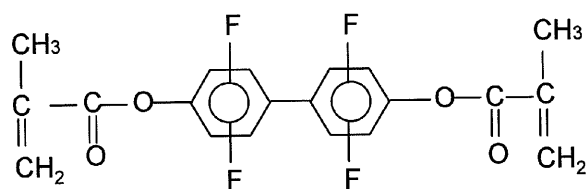
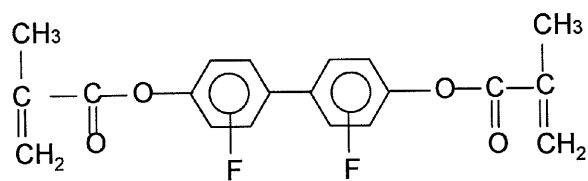
ある実施形態において、前記ビニル系モノマーはジメタクリレートモノマーである。

## 【0023】

ある実施形態において、前記ビニル系モノマーは構造式(1a)

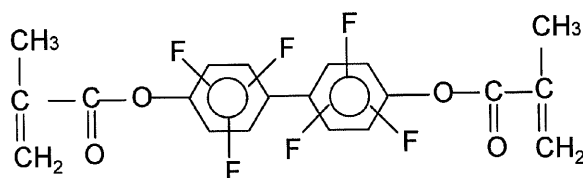
50

【化 1】



(1a)

10



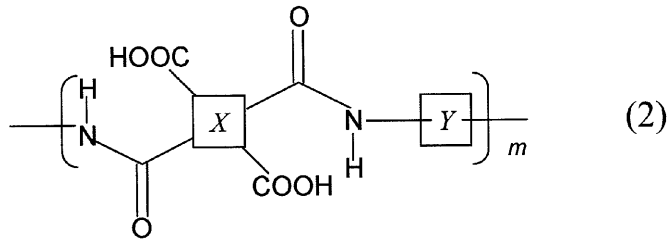
20

で表される。

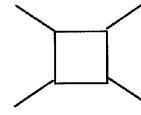
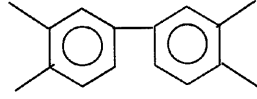
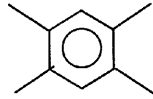
【 0 0 2 4 】

ある実施形態において、前記第 1 ポリイミドの前駆体は一般式 ( 2 )

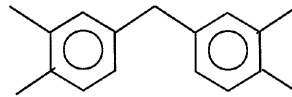
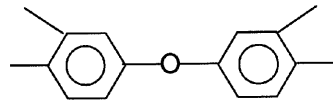
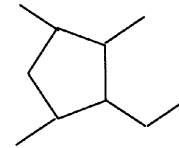
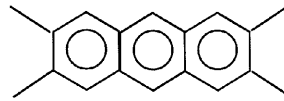
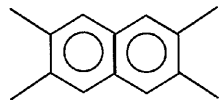
## 【化 2】



X

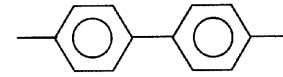
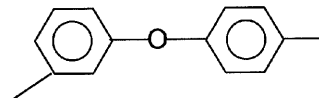
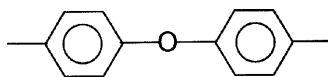
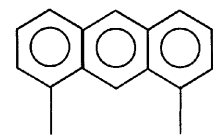
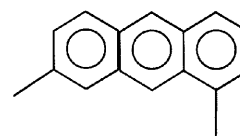
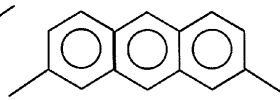
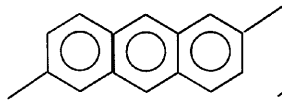
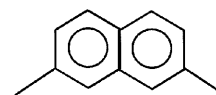
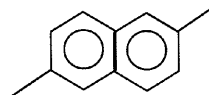
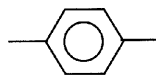
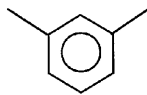


10

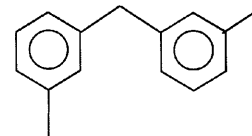
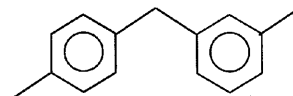
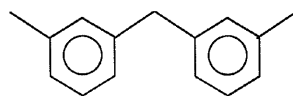
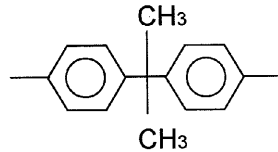
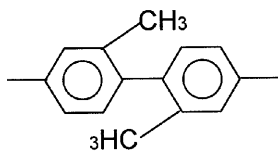


20

Y



30



40

で表される。

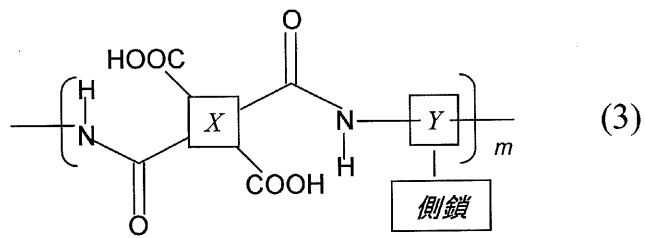
## 【0025】

ある実施形態において、前記第1ポリイミドの前駆体の側鎖は垂直配向性基を有しない。

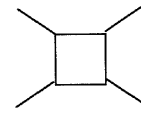
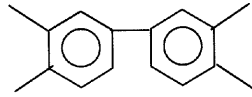
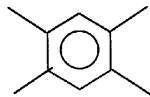
## 【0026】

ある実施形態において、前記第2ポリイミドの前駆体は一般式(3)

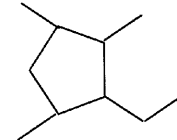
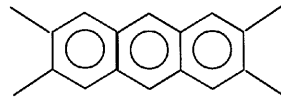
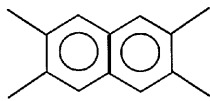
## 【化 3】



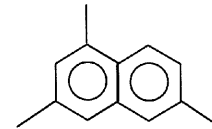
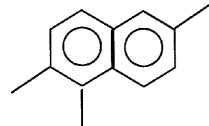
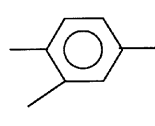
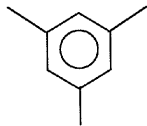
X



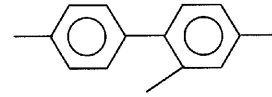
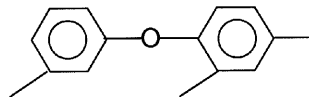
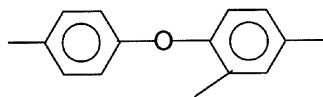
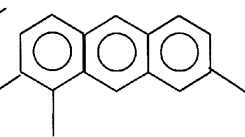
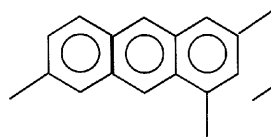
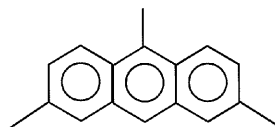
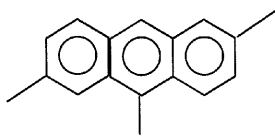
10



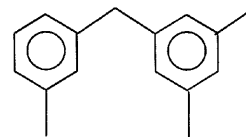
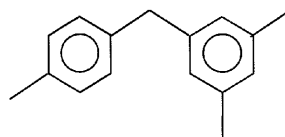
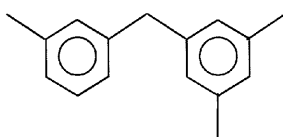
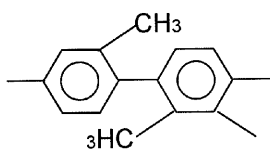
Y



20



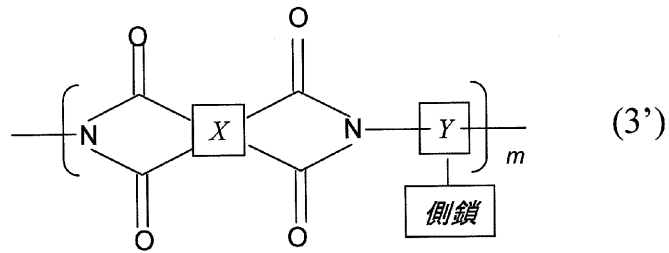
30



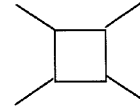
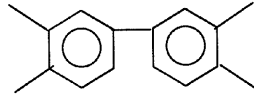
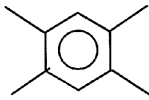
40

で表され、前記第 2 ポリイミドは一般式 ( 3 ' )

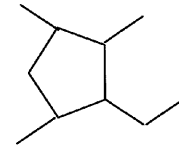
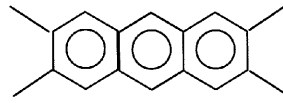
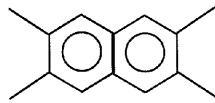
## 【化 4】



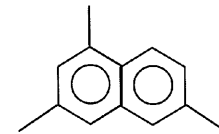
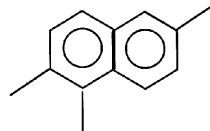
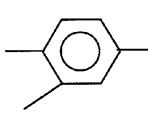
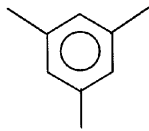
X



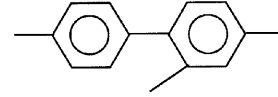
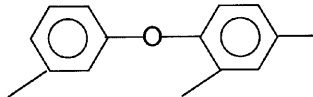
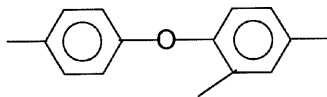
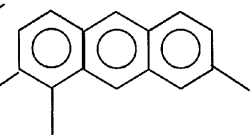
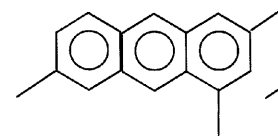
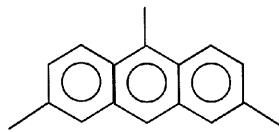
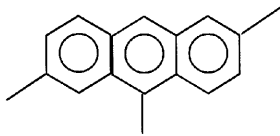
10



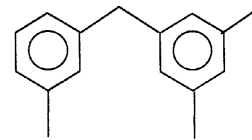
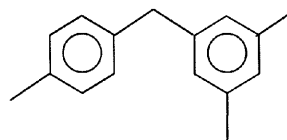
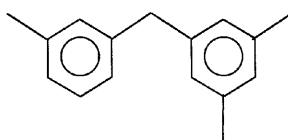
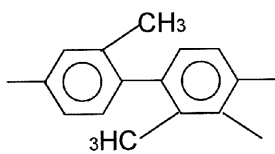
Y



20



30



40

で表される。

【 0 0 2 7 】

ある実施形態において、前記第 2 ポリイミドはフッ素基を含む側鎖を有する。

【 0 0 2 8 】

ある実施形態において、前記第 2 ポリイミドは光反応性官能基を有する。

【 0 0 2 9 】

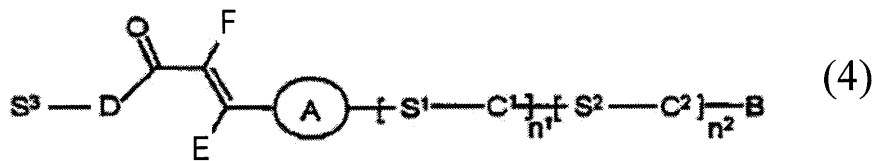
ある実施形態において、前記光反応性官能基は、シンナメート基、カルコン基、トラン  
基、クマリン基およびアゾベンゼン基からなる群から選択された少なくとも一つである。

50

## 【 0 0 3 0 】

ある実施形態において、前記第 2 ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方は一般式 ( 4 )

## 【 化 5 】



10

で表される側鎖を有する。

## 【 0 0 3 1 】

ある実施形態において、前記第 2 ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方は垂直配向性基を含む側鎖を有する。

## 【 0 0 3 2 】

ある実施形態において、前記配向膜材料に対する前記ビニル系モノマーの濃度は 2 w t % 以上 2 0 w t % 以下である。

## 【 0 0 3 3 】

本発明による配向膜は、第 1 ポリイミドと、前記第 1 ポリイミドとは異なる第 2 ポリイミドと、ビニル系モノマーの重合したポリビニル化合物とを備える、配向膜であって、前記ビニル系モノマーは、一般式 ( 1 )  $\text{P}1 - \text{A}1 - (\text{Z}1 - \text{A}2)_n - \text{P}2$  ( 一般式 ( 1 ) において、 $\text{P}1$  および  $\text{P}2$  は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  は、独立に、1, 4 - フェニレン、1, 4 - シクロヘキサンまたは 2, 5 - チオフェン、もしくは、ナフタレン - 2, 6 - ジイルまたはアントラセン - 2, 7 - ジイルを表し、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  の少なくとも一方は少なくとも 1 個のフッ素基で置換されており、 $\text{Z}1$  は -  $\text{C}(\text{O})\text{O}$  - 、 -  $\text{O}(\text{C})\text{O}$  - 、 -  $\text{O}$  - 、 -  $\text{C}(\text{O})\text{NH}$  - 基または単結合であり、 $n$  は 0 または 1 である ) で表される。

20

## 【 0 0 3 4 】

ある実施形態において、前記配向膜は、前記第 1 ポリイミドを含む第 1 配向層と、前記第 2 ポリイミドを含む第 2 配向層とを有している。

30

## 【 0 0 3 5 】

ある実施形態において、前記ポリビニル化合物は、前記第 2 配向層内および前記第 2 配向層の表面に存在する。

## 【 0 0 3 6 】

本発明による液晶表示装置は、画素電極を有するアクティブマトリクス基板と、対向電極を有する対向基板と、前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に設けられた垂直配向型の液晶層とを備える、液晶表示装置であって、前記アクティブマトリクス基板および前記対向基板の少なくとも一方は前記液晶層側に設けられた配向膜をさらに有しており、前記配向膜は、第 1 ポリイミドと、前記第 1 ポリイミドとは異なる第 2 ポリイミドと、ビニル系モノマーの重合したポリビニル化合物とを有しており、前記ビニル系モノマーは、一般式 ( 1 )  $\text{P}1 - \text{A}1 - (\text{Z}1 - \text{A}2)_n - \text{P}2$  ( 一般式 ( 1 ) において、 $\text{P}1$  および  $\text{P}2$  は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  は、独立に、1, 4 - フェニレン、1, 4 - シクロヘキサンまたは 2, 5 - チオフェン、もしくは、ナフタレン - 2, 6 - ジイルまたはアントラセン - 2, 7 - ジイルを表し、 $\text{A}1$  および  $\text{A}2$  の少なくとも一方は少なくとも 1 個のフッ素基で置換されており、 $\text{Z}1$  は -  $\text{C}(\text{O})\text{O}$  - 、 -  $\text{O}(\text{C})\text{O}$  - 、 -  $\text{O}$  - 、 -  $\text{C}(\text{O})\text{NH}$  - 基または単結合であり、 $n$  は 0 または 1 である ) で表される。

40

## 【 0 0 3 7 】

ある実施形態において、前記配向膜は、前記第 1 ポリイミドを含む第 1 配向層と、前記

50

第2ポリイミドを含む第2配向層とを有している。

【0038】

ある実施形態において、前記第2配向層は前記第1配向層よりも前記液晶層側に設けられており、前記ポリビニル化合物は前記第2配向層内および前記第2配向層の表面に存在する。

【0039】

ある実施形態において、前記配向膜は、電圧無印加時に前記液晶層の液晶分子が前記配向膜の主面の法線方向から傾くように前記液晶分子を規定する。

【0040】

ある実施形態において、前記液晶表示装置は複数の画素を有しており、前記液晶層は、前記複数の画素のそれぞれに対して、基準配向方位の互いに異なる複数の液晶ドメインを有している。

10

【0041】

ある実施形態において、前記複数の液晶ドメインは4つの液晶ドメインである。

【0042】

本発明による配向膜の形成方法は、第1ポリイミドの前駆体と、前記第1ポリイミドとは異なる第2ポリイミドおよびその前駆体の少なくとも一方と、ビニル系モノマーとを含有する配向膜材料を用意する工程と、前記配向膜材料を塗布する工程と、前記配向膜材料を加熱する工程であって、前記第1ポリイミドの前駆体の少なくとも一部を前記第1ポリイミドにイミド化し、前記ビニル系モノマーを重合してポリビニル化合物を形成する工程とを包含する。

20

【0043】

ある実施形態では、前記配向膜材料を用意する工程において、前記ビニル系モノマーは、一般式(1)  $P1-A1-(Z1-A2)_n-P2$  (一般式(1)において、P1およびP2は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、A1およびA2は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、A1およびA2の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、Z1は-COO-、-OCO-、-O-、-CONH-基または単結合であり、nは0または1である)で表される。

30

【0044】

ある実施形態では、前記加熱する工程の後、前記第2ポリイミドのイミド化率は前記第1ポリイミドのイミド化率よりも大きい。

【0045】

ある実施形態では、前記配向膜材料を塗布する工程は、前記配向膜材料の塗布を印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で行う工程を含む。

【発明の効果】

【0046】

本発明によれば、プレチルト角の変化に起因する焼き付きを抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

40

【0047】

【図1】本発明による配向膜の実施形態の模式的な断面図である。

【図2】(a)は本発明による液晶表示装置の実施形態の模式図であり、(b)は本実施形態の液晶表示装置における液晶パネルの模式図である。

【図3】配向層の厚さとポリイミドの側鎖にあるフッ素基の密度との関係を示すグラフである。

【図4】(a)~(c)は、それぞれ、本実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するための模式図である。

【図5】(a)は本実施形態の液晶表示装置における配向膜の模式図であり、(b)は配向膜の模式図であり、(c)は液晶ドメインの中央の液晶分子の配向方向を示す模式図で

50

ある。

【図 6】(a) は、実施例 1 - 1 の液晶表示装置における液晶分子の配向状態を示す模式図であり、(b) は、観察者側からみた第 1、第 2 配向膜の配向処理方向を示す模式図である。

【図 7】実施例 4 の液晶表示装置において、観察者側からみた第 1、第 2 配向膜の配向処理方向を示す模式図である。

【図 8】実施例 5 の液晶表示装置において、観察者側からみた第 1、第 2 配向膜の配向処理方向を示す模式図である。

【発明を実施するための形態】

【0048】

10

以下、図面を参照して、本発明による配向膜、配向膜材料および配向膜を有する液晶表示装置の実施形態を説明する。

【0049】

図 1 に、本実施形態の配向膜 100 の模式図を示す。配向膜 100 は、第 1 ポリイミド p1 と、第 2 ポリイミド p2 と、ポリビニル化合物 pv とを含有している。配向膜 100 は、第 1 ポリイミド p1 を含む第 1 配向層 102 と、第 2 ポリイミド p2 を含む第 2 配向層 104 とに二層分離されている。第 1 配向層 102 の主成分は第 1 ポリイミド p1 であり、第 2 配向層 104 の主成分は第 2 ポリイミド p2 である。第 1 ポリイミド p1 は、電圧印加後の電気的特性の変動の小さいものである。第 2 ポリイミド p2 は、配向処理に対する液晶分子のプレチルト角の変化の大きいものである。

20

【0050】

第 2 配向層 104 は、第 1 配向層 102 よりも上側に位置しており、一般的に、第 2 配向層 104 は第 1 配向層 102 よりも薄い。また、配向膜 100 はこのように完全に二層分離されていなくてもよい。

【0051】

配向膜 100 において、第 1、第 2 ポリイミド p1、p2 の主鎖はほぼ一方方向に配列されている。第 2 ポリイミド p2 の主鎖または側鎖は光反応性官能基を有していてもよい。光反応性官能基は、例えば、シンナメート基、カルコン基、トラン基、クマリン基およびアゾベンゼン基のいずれかである。あるいは、第 2 ポリイミド p2 の側鎖は垂直配向性を有していてもよい。第 1、第 2 ポリイミド p1、p2 は、異なるポリイミド前駆体のイミド化（重合）によって形成される。

30

【0052】

本実施形態の配向膜 100 のポリビニル化合物 pv はフッ素基を有しており、ポリビニル化合物 pv はフッ素基を有するビニル系モノマーの重合によって形成される。ポリビニル化合物 pv は、第 2 配向層 104 内および第 2 配向層 104 の表面に存在している。重合は、ビニル系モノマーに熱または光を付与することによって行われる。

【0053】

配向膜 100 は以下のように形成される。まず、配向膜材料を用意する。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p2 およびその前駆体の少なくとも一方と、フッ素基を有するビニル系モノマーとを溶媒に溶解させたものである。配向膜材料に対するビニル系モノマーの濃度は 2 wt % 以上 20 wt % 以下である。

40

【0054】

配向膜材料における第 2 ポリイミド p2 のイミド化率は 0 % 以上 100 % 以下であってもよい。なお、第 1 ポリイミド p1 のイミド化率が低いほど残留 DC 電圧の抑制効果が高いと考えられる。

【0055】

配向膜材料において、第 2 ポリイミド p2 のイミド化率は第 1 ポリイミド p1 のイミド化率よりも高いことが好ましい。例えば、イミド化率 0 % である水平配向用ポリイミドの前駆体と、イミド化率が 0 % よりも高い垂直配向用ポリイミドおよび前駆体とを用意し、これらを溶媒に溶解させ、さらに、フッ素基を有するビニル系モノマーを溶媒に溶解させ

50

てもよい。なお、第2ポリイミドおよびその前駆体の濃度は第1ポリイミドの前駆体の濃度よりも低い。

【0056】

配向膜材料の塗布は、印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で行われる。次に、配向膜材料の溶媒を除去する。例えば、加熱処理を行うことにより、溶媒の除去が行われる。また、加熱処理により、第1ポリイミドp1の前駆体が第1ポリイミドp1にイミド化し、第2ポリイミドp2の前駆体が第2ポリイミドp2にイミド化する。このとき、二層分離が起こり、第1ポリイミドp1を含む第1配向層102および第2ポリイミドp2を含む第2配向層104が形成される。なお、配向膜100においても、第2ポリイミドp2のイミド化率は第1ポリイミドp1のイミド化率よりも高いことが好ましい。

10

【0057】

また、加熱処理により、ビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物pvが形成される。ビニル系モノマーはフッ素基を有しているため、フッ素基の表面張力により、ポリビニル化合物pvは第2配向層104内および第2配向層104の表面に形成される。このように、ポリビニル化合物pvが配向膜100の表面およびその近傍に存在することにより、液晶分子のプレチルト角の変化を効率的に抑制することができる。

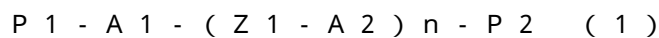
【0058】

ここで、ビニル系モノマーは複数のビニル基( $\text{CH}_2=\text{CH}-$ )を有する多官能モノマーであり、ポリビニル化合物pvは多官能モノマーの重合体である。例えば、多官能モノマーはジメタクリレート、ジアクリレート、ジアクリルアミドまたはジメタクリルアミドである。このような多官能モノマーのビニル基は、例えば、メタクリレート基、アクリレート基、アクリルアミド基またはメタクリルアミド基の一部である。

20

【0059】

ビニル系モノマーは一般式(1)で表される。



【0060】

なお、一般式(1)において、P1およびP2は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、A1およびA2は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、A1およびA2の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、Z1は $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 基または単結合であり、nは0または1である。

30

【0061】

このように、多官能モノマーが複数のビニル基を有していることにより、多官能モノマーの重合によって形成されたポリビニル化合物pvは3次元的な網目構造を有する。また、この多官能モノマーは、複数のビニル基の間に、2以上の直接結合された環構造または1以上の縮環構造を有しており、変形に対する自由度が低く、ポリビニル化合物は応力に対して変形しにくい。このようなポリビニル化合物pvを含有することにより、配向膜100は構造的に安定化され、配向特性の変動が抑制される。

【0062】

また、本実施形態では、異なるポリイミドの前駆体を混合した配向膜材料の塗布、および、加熱処理による2つの配向層102、104の形成を一括的に行っている。これにより、配向膜100の形成のための処理工程および時間の短縮を図ることができる。

40

【0063】

以下、図2を参照して、本実施形態の配向膜110、120を有する液晶表示装置200を説明する。図2(a)に、液晶表示装置200の模式図を示す。液晶表示装置200は、液晶パネル300と、液晶パネル300を駆動する駆動回路350と、駆動回路350を制御する制御回路360とを備えている。また、図示していないが、液晶表示装置200は必要に応じてバックライトを備えていてもよい。

【0064】

50

図 2 ( b ) に示すように、液晶パネル 3 0 0 は、第 1 配向膜 1 1 0 を有するアクティブマトリクス基板 2 2 0 と、第 2 配向膜 1 2 0 を有する対向基板 2 4 0 と、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に設けられた液晶層 2 6 0 とを備えている。アクティブマトリクス基板 2 2 0 は、第 1 絶縁基板 2 2 2 と、画素電極 2 2 4 とをさらに有しており、第 1 配向膜 1 1 0 は画素電極 2 2 4 を覆っている。また、対向基板 2 4 0 は、第 2 絶縁基板 2 4 2 と、対向電極 2 4 4 とをさらに有しており、第 2 配向膜 1 2 0 は対向電極 2 4 4 を覆っている。液晶層 2 6 0 は、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に挟まれている。例えば、第 1、第 2 絶縁基板 2 2 2、2 4 2 は透明なガラス基板である。

#### 【 0 0 6 5 】

液晶表示装置 2 0 0 には、複数の行および複数の列に沿ったマトリクス状の画素が設けられている。アクティブマトリクス基板 2 2 0 には、各画素に対して少なくとも 1 つのスイッチング素子（例えば、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor : TFT））（ここでは図示せず）が設けられており、アクティブマトリクス基板 2 2 0 は TFT 基板とも呼ばれる。本明細書において「画素」とは、表示において特定の階調を表現する最小の単位を指し、カラー表示においては、例えば、R、G および B のそれぞれの階調を表現する単位に対応し、ドットとも呼ばれる。R 画素、G 画素および B 画素の組み合わせが、1 つのカラー表示画素を構成する。「画素領域」は、表示の「画素」に対応する液晶パネル 3 0 0 の領域を指す。

#### 【 0 0 6 6 】

なお、図示していないが、アクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 のそれぞれには、偏光板が設けられている。したがって、2 つの偏光板は液晶層 2 6 0 を挟んで互いに対向するように配置されている。2 つの偏光板の透過軸（偏光軸）は、互いに直交するように配置されており、一方が水平方向（行方向）、他方が垂直方向（列方向）に沿うように配置されている。

#### 【 0 0 6 7 】

第 1 配向膜 1 1 0 は、第 1 ポリイミド p 1、第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v を含有している。第 1 配向膜 1 1 0 は、第 1 ポリイミド p 1 を含む第 1 配向層 1 1 2 および第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 1 1 4 に二層分離されている。第 2 配向層 1 1 4 は第 1 配向層 1 1 2 よりも液晶層 2 6 0 側に位置している。

#### 【 0 0 6 8 】

同様に、第 2 配向膜 1 2 0 は、第 1 ポリイミド p 1、第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v を含有しており、第 2 配向膜 1 2 0 は、第 1 ポリイミド p 1 を含む第 1 配向層 1 2 2 および第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 1 2 4 に二層分離されている。第 2 配向層 1 2 4 は第 1 配向層 1 2 2 よりも液晶層 2 6 0 側に位置している。

#### 【 0 0 6 9 】

第 1 ポリイミド p 1 はその前駆体をイミド化することによって形成される。また、第 2 ポリイミド p 2 もその前駆体をイミド化することによって形成される。ポリビニル化合物 p v はビニル系モノマーの重合によって形成される。重合は、ビニル系モノマーに対して熱または光を付与することによって行われる。

#### 【 0 0 7 0 】

第 1 配向膜 1 1 0 は配向膜材料から形成される。配向膜材料は、例えば、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 および / またはその前駆体と、ビニル系モノマーとを溶媒に溶解させたものである。例えば、配向膜材料を画素電極 2 2 4 上に塗布した後、加熱処理を行い、溶媒の蒸発およびイミド化・重合を行うことにより、第 1 ポリイミド p 1、第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v を含有する第 1 配向膜 1 1 0 が形成される。加熱処理は、例えば、異なる温度で 2 回行われる。同様に、配向膜材料を対向電極 2 4 4 上に塗布した後、加熱処理を行い、溶媒の蒸発およびイミド化・重合を行うことにより、第 1 ポリイミド p 1、第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v を含有する第 2 配向膜 1 2 0 が形成される。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 7 1 】

液晶層 2 6 0 は負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料（液晶分子 2 6 2）を含有している。第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 は、それぞれ、垂直配向膜の表面に対して、液晶分子 2 6 2 のプレチルト角が 9 0 ° 未満となるように処理される。液晶分子 2 6 2 のプレチルト角は、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 の主面と、プレチルト方向に規定された液晶分子 2 6 2 の長軸とのなす角度である。

## 【 0 0 7 2 】

液晶層 2 6 0 は垂直配向型であるが、第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 1 1 4、1 2 4 により、その近傍の液晶分子 2 6 2 は第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の主面の法線方向からわずかに傾いている。プレチルト角は、例えば 8 5 ° から 8 9 . 7 ° の範囲内である。プレチルト角は、例えば、クリスタルローテーション法で測定される。また、第 2 ポリイミド p 2 の側鎖により、液晶分子 2 6 2 のプレチルト方向が規定される。以下の説明において、この成分をプレチルト角発現成分とも呼ぶことがある。

10

## 【 0 0 7 3 】

なお、第 1 配向膜 1 1 0 による液晶分子 2 6 2 のプレチルト方位は第 2 配向膜 1 2 0 による液晶分子 2 6 2 のプレチルト方位とは異なる。例えば、第 1 配向膜 1 1 0 による液晶分子 2 6 2 のプレチルト方位は第 2 配向膜 1 2 0 による液晶分子 2 6 2 のプレチルト方位と 9 0 ° 交差している。なお、ここでは、液晶層 2 6 0 にカイラル剤は添加されておらず、液晶層 2 6 0 に電圧を印加すると、液晶層 2 6 0 内の液晶分子は第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の配向規制力に従ってツイスト配向をとる。ただし、必要に応じて液晶層 2 6 0 にカイラル剤が添加されていてもよい。液晶層 2 6 0 はクロスニコル配置された偏光板と組み合わせられてノーマリーブラックモードの表示を行う。

20

## 【 0 0 7 4 】

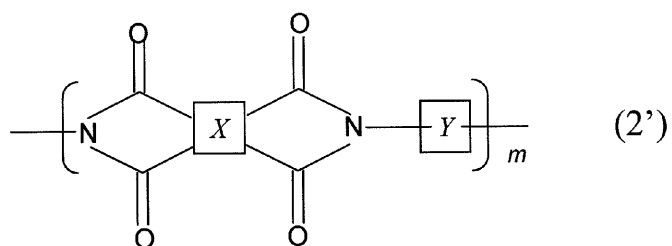
また、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 のそれぞれは画素ごとに複数の配向領域を有してもよい。例えば、第 1 配向膜 1 1 0 の一部をマスキングして、第 1 配向膜 1 1 0 の所定の領域にある方向から光を照射した後、光の照射されなかった別の領域に異なる方向から光を照射する。さらに、第 2 配向膜 1 2 0 も同様に形成される。このようにして、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 のそれぞれに、異なる配向規制力を付与する領域を形成することができる。

## 【 0 0 7 5 】

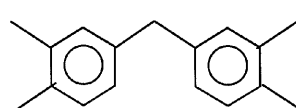
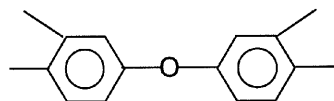
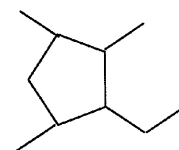
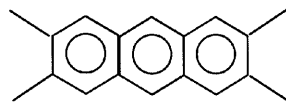
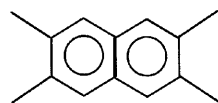
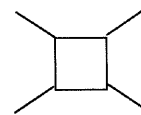
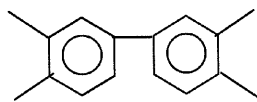
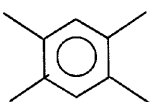
例えば、第 1 ポリイミド p 1 は一般式（2'）で表される。

30

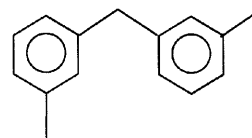
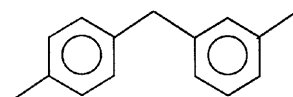
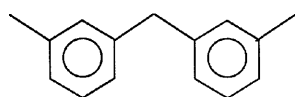
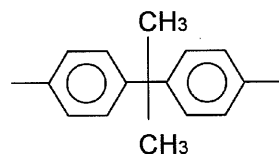
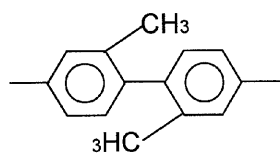
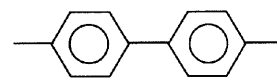
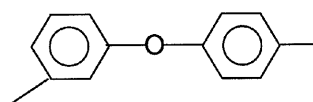
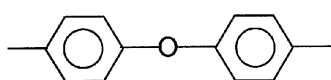
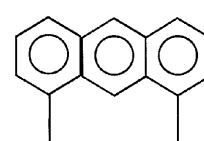
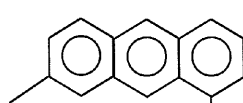
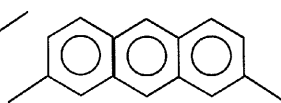
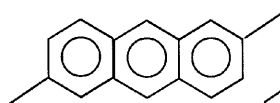
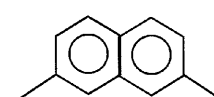
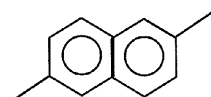
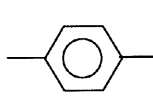
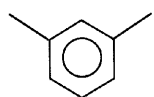
【化 6】



X



Y



【 0 0 7 6 】

さらに具体的には、第 1 ポリイミド p 1 は構造式 ( 2 a ' ) で表される。

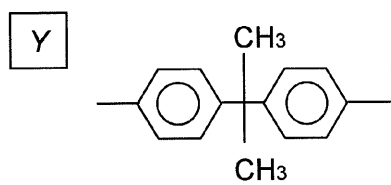
10

20

30

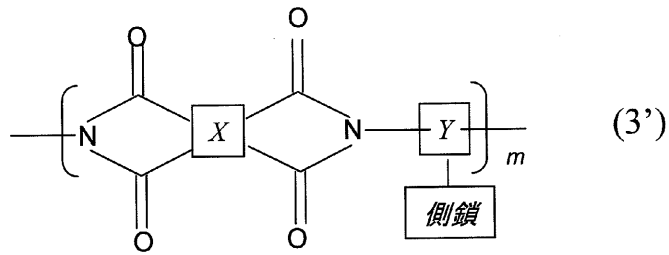
40

10

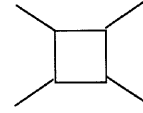
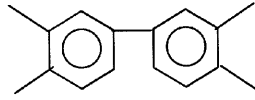
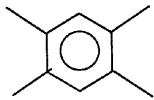


例えば、第 2 ポリイミド p 2 は一般式 ( 3 ' ) で表される。

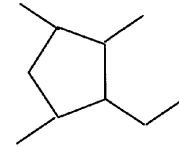
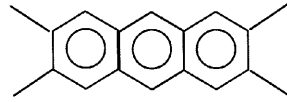
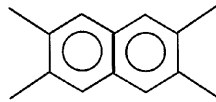
## 【化 8】



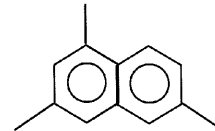
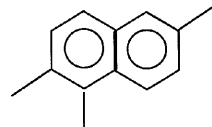
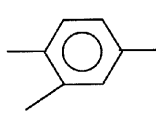
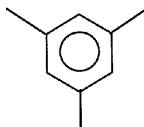
X



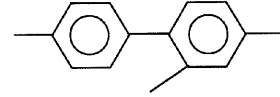
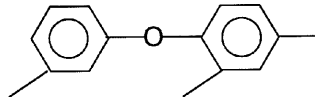
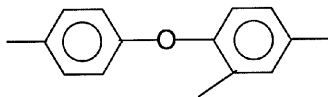
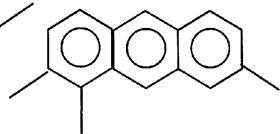
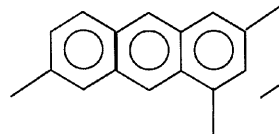
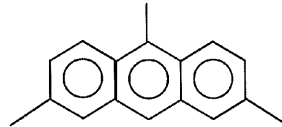
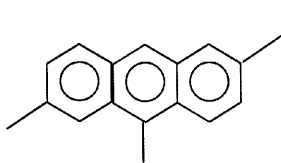
10



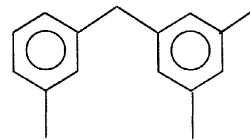
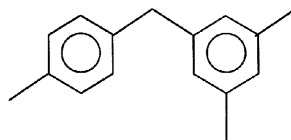
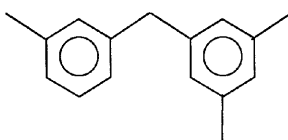
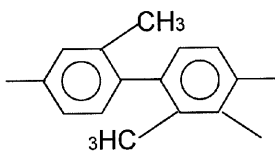
Y



20



30



40

## 【0078】

なお、第2ポリイミドp2の側鎖はフッ素原子を含んでいてもよい。側鎖がフッ素原子を含むことにより、上述した焼き付きがある程度抑制される。

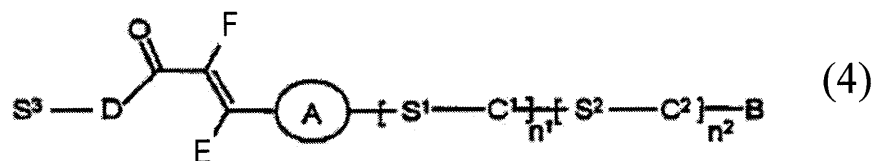
## 【0079】

また、第2ポリイミドp2は光反応性官能基を含んでいてもよい。この場合、光照射により、二量化サイトが形成される。このような第2ポリイミドp2を含む第2配向層114、124は光配向層とも呼ばれる。例えば、第2ポリイミドp2は側鎖(Side Chain)に光反応性官能基を有してもよく、第2ポリイミドp2の側鎖は一般式(4)

50

で表される。

【化 9】



【0080】

10

ここで、Aは、場合によりフッ素、塩素、シアノから選択される基によるか、またはC<sub>1-18</sub>環式、直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル残基（これは、場合により1個のシアノ基または1個以上のハロゲン原子で置換されており、そして、場合により、アルキルの隣接しない1個以上の-CH<sub>2</sub>-基は、基Qで置き換えられている）で置換されている、ピリミジン-2,5-ジイル、ピリジン-2,5-ジイル、2,5-チオフェニレン、2,5-フラニレン、1,4-若しくは2,6-ナフチレンまたはフェニレンを表す。

【0081】

また、Bは、非置換か、シアノ若しくはハロゲンで単置換されているか、またはハロゲンで多置換されている、炭素原子3～18個を有する直鎖状または分岐鎖状のアルキル残基（ここで、隣接しない1個以上のCH<sub>2</sub>基は、独立して基Qで置き換えられていてもよい）である。

20

【0082】

また、C<sup>1</sup>およびC<sup>2</sup>は、互いに独立して、芳香族または脂環式基（これは、非置換か、あるいはフッ素、塩素、シアノまたは環式、直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル残基（これは、非置換か、シアノ若しくはハロゲンで単置換されているか、またはハロゲンで多置換されており、炭素原子1～18個を有し、隣接しない1個以上のCH<sub>2</sub>基は、独立して基Qで置き換えられていてもよい）で置換されている）を表す。また、Dは、酸素原子またはNR<sup>1</sup>-（ここで、R<sup>1</sup>は、水素原子または低級アルキルを表す）を表す。

【0083】

S<sup>1</sup>およびS<sup>2</sup>は、互いに独立して、共有単結合またはスペーサ単位を表す。また、S<sup>3</sup>は、スペーサ単位を表す。

30

【0084】

また、Qは、-O-、-CO-、-CO-O-、-O-CO-、-Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-O-Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-、-NR<sup>1</sup>-、-NR<sup>1</sup>-CO-、-CO-NR<sup>1</sup>-、-NR<sup>1</sup>-CO-O-、-O-CO-NR<sup>1</sup>-、-NR<sup>1</sup>-CO-NR<sup>1</sup>-、-CH=CH-、-C=C-および-O-CO-O-（ここで、R<sup>1</sup>は、水素原子または低級アルキルを表す）から選択される基を表す。E、Fは、互いに独立して、水素、フッ素、塩素、シアノ、場合によりフッ素で置換され、炭素原子1～12個を有するアルキル（ここで、場合により隣接しない1個以上のCH<sub>2</sub>基は、-O-、-CO-O-、-O-CO-および/または-CH=CH-で置き換えられている）を表す。

40

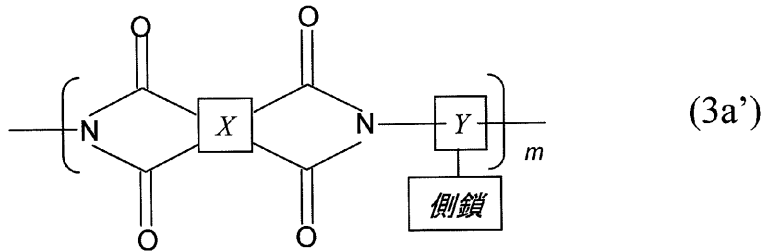
【0085】

なお、Aに芳香族化合物があること、Bに炭化フッ素があること、Dに少なくとも1個以上の炭化水素基があること、E、Fに水素原子があることが好ましい。

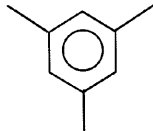
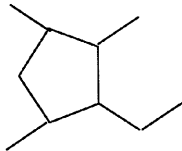
【0086】

具体的には、第2ポリイミドp2は構造式(3a')で表される。

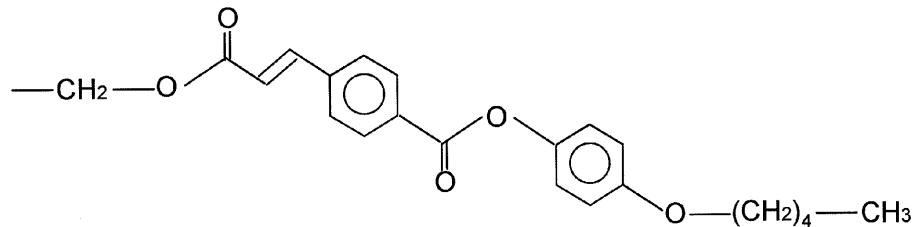
【化 1 0】



10



20



30

【0087】

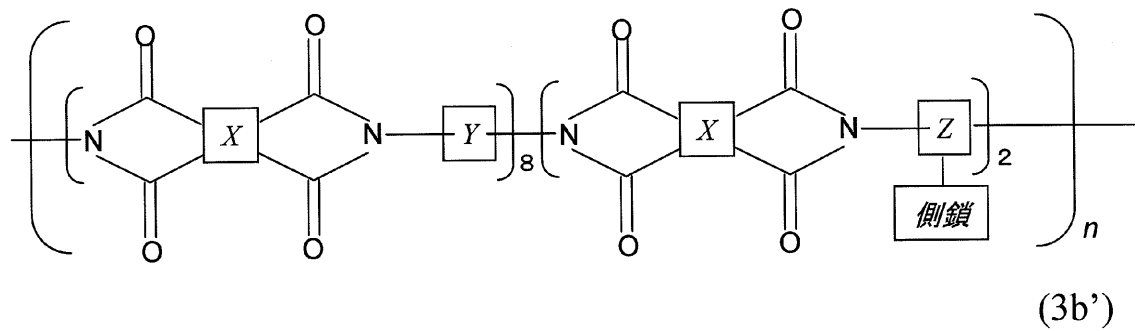
この場合、第1、第2配向膜110、120に対してその主面の法線方向の斜め方向から光を照射することにより、第2ポリイミドp2に、電圧無印加時において液晶分子262が第1、第2配向膜110、120の主面の法線方向から傾いて配向するように配向規制力が付与される。構造式(3a')で表される第2ポリイミドp2は光配向性ポリイミドとも呼ばれており、このような処理は光配向処理とも呼ばれる。光配向処理は非接触で行われるので、ラビング処理のように摩擦による静電気の発生が無く、歩留まりを向上させることができる。

40

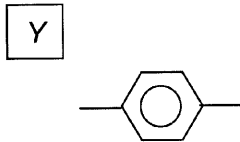
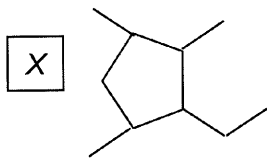
【0088】

また、上述した説明では、第2ポリイミドp2は光反応性官能基を有しており、配向処理として光配向処理が行われるが、本発明はこれに限定されない。第2ポリイミドp2の側鎖は垂直配向性基を有しており、配向処理としてラビング処理またはイオンビームの照射を行ってもよい。例えば、第2ポリイミドp2は構造式(3b')で表される。

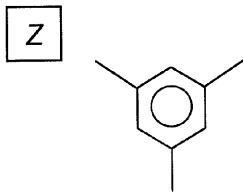
## 【化 1 1】



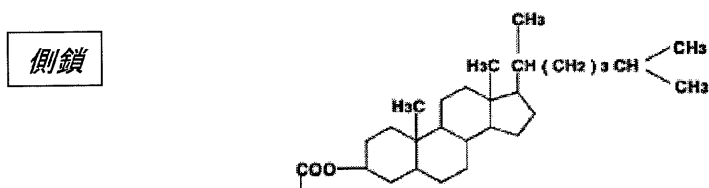
10



20



30



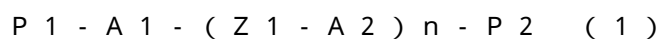
## 【0089】

40

第2ポリイミドp2は垂直配向性基を含む側鎖を有しており、第2ポリイミドp2は垂直配向性ポリイミドとも呼ばれている。第1、第2配向膜110、120の形成後に、第1、第2配向膜110、120に対してラビング処理またはイオンビームの照射を行うことにより、液晶分子262にプレチルトを付与することができる。

## 【0090】

ポリビニル化合物pvはビニル系モノマーを重合したものである。ビニル系モノマーは、一般式(1)で表される。



## 【0091】

なお、一般式(1)において、P1およびP2は、独立に、アクリレート、メタクリレ

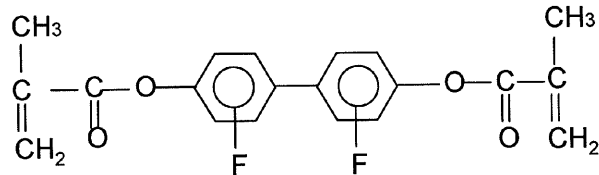
50

ート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、A 1 および A 2 は、独立に、1, 4 - フェニレン、1, 4 - シクロヘキサンまたは 2, 5 - チオフェン、もしくは、ナフタレン - 2, 6 - ジイルまたはアントラセン - 2, 7 - ジイルを表し、A 1 および A 2 の少なくとも一方は少なくとも 1 個のフッ素基で置換されており、Z 1 は - C O O - 、 - O C O - 、 - O - 、 - C O N H - 基または単結合であり、n は 0 または 1 である。

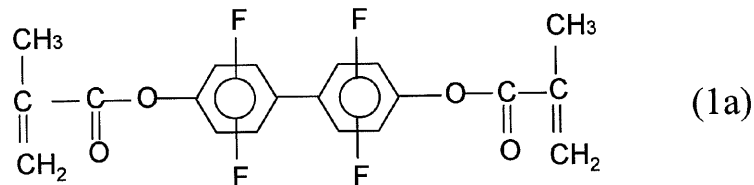
【0092】

ビニル系モノマーは、例えば構造式 (1 a) で表される。

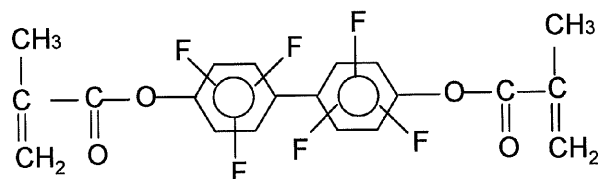
【化 1 2】



10



20



30

【0093】

構造式 (1 a) に示したビニル系モノマーはビフェニルジメタクリレートである。ビニル系モノマーの主鎖は 2 つの環状構造を有していてもよく、また、2 つの環状構造のそれぞれがフッ素基に置換されていてもよい。また、1 つの環状構造が 1、2 または 3 のフッ素基を有していてもよい。また、ビニル系モノマーは対称な構造を有する 2 官能モノマーであることが好ましい。

【0094】

なお、第 1 配向膜 1 1 0 の第 2 配向層 1 1 4 の内部および表面のそれぞれに第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v の両方が存在している。しかしながら、第 1 配向層 1 1 2 には第 1 ポリイミド p 1 は存在しているが、ポリビニル化合物 p v は存在していない。同様に、第 2 配向膜 1 2 0 の第 2 配向層 1 2 4 の内部および表面のそれぞれに第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v の両方が存在している。しかしながら、第 1 配向層 1 2 2 には第 1 ポリイミド p 1 は存在しているが、ポリビニル化合物 p v は存在していない。

40

【0095】

このように、ポリビニル化合物 p v が第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の表面およびその近傍に存在していることにより、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 が構造的に安定化され、配向機能の変化が抑制され、液晶層 2 6 0 の液晶分子 2 6 2 のプレチルト角が維持される。なお、ビニル系モノマーは単官能モノマーである場合、重合体として形成される細長い直鎖状のポリマーは変形しやすいので、配向機能の変化を十分に抑制することはでき

50

ないが、ビニル系モノマーが多官能モノマーであることにより、その重合体は配向機能の変化を十分に抑制できる。なお、配向膜 110、120 は、ポリビニル化合物 p v だけでなくポリイミド p 1、p 2 を含有しており、配向膜 110、120 の耐熱性、耐溶媒性および吸湿性等の特性は、ポリイミドのみから形成された一般的な配向膜と比べて実質的に低下しない。

#### 【0096】

第 1、第 2 配向膜 110、120 の表面におけるポリビニル化合物 p v の濃度は第 1、第 2 配向膜 110、120 の内部よりも極めて高い。ポリビニル化合物 p v の濃度は、例えば、飛行時間型 2 次イオン質量分析法 (Time Of Flight - Secondary Ion Mass Spectrometry: TOF - SIMS) または X 線電子分光法 (X-ray Photoelectron Spectroscopy: XPS) で測定される。なお、XPS では、例えばアルバック・ファイ社製の装置を用いて C60 でエッチングしながら深さ方向の原子を分析することができる。

10

#### 【0097】

上述したように、ビニル系モノマーはフッ素基を有しているため、フッ素基の表面張力により、ポリビニル化合物 p v は第 2 配向層 114、124 の表面およびその近傍に存在している。このように、ポリビニル化合物 p v が第 1、第 2 配向膜 110、120 の表面およびその近傍に存在することにより、液晶分子 262 のプレチルト角の変化を効率的に抑制することができる。

20

#### 【0098】

なお、第 2 ポリイミドおよびその前駆体の側鎖がフッ素基を含む場合、ビニル系モノマーがフッ素基を有しないと、表面張力が低いため、第 1、第 2 配向膜の表面およびその近傍に形成されるポリビニル化合物の量が著しく低下してしまう。しかしながら、ビニル系モノマーがフッ素基を有することにより、第 2 ポリイミドおよびその前駆体の側鎖がフッ素基を含んでいても、ポリビニル化合物 p v は第 1、第 2 配向膜 110、120 の表面に形成される。なお、第 2 ポリイミドの側鎖はフッ素基を有していてもよいが、プレチルト角の変化の抑制の観点から、第 2 ポリイミドの側鎖のフッ素基は少ないほど好ましい。

#### 【0099】

また、プレチルト角の変化に起因する焼き付きを抑制するための別の技術として Polymer Sustained Alignment Technology (以下、「PSA 技術」という) が知られている。PSA 技術では、少量の重合性化合物 (例えば光重合性モノマー) の混合された液晶層に電圧を印加した状態で重合性化合物に活性エネルギー線 (例えば紫外光) を照射して生成される重合体によって液晶分子のプレチルト方向が制御される。

30

#### 【0100】

ここで、一般的な PSA 技術において形成される配向維持層と、本実施形態の液晶表示装置 200 の配向膜 110、120 におけるポリビニル化合物 p v との違いを説明する。

#### 【0101】

PSA 技術では、配向維持層が配向膜上に存在しており、液晶パネルを分解してアクティブマトリクス基板または対向基板表面を TOF - SIMS や XPS で分析すると、基板の最表面からは重合成分由来のイオンや原子が検出される。これに対して、本実施形態の表示装置 200 では、ポリビニル化合物 p v は配向膜 110、120 に含有されており、液晶パネルを分解して同様にアクティブマトリクス基板 220 または対向基板 240 の表面を分析すると、ポリビニル化合物 p v 由来のイオンまたは原子だけでなく第 2 配向層 114、124 の第 2 ポリイミド p 2 由来のイオンまたは原子が検出される。このことから、アクティブマトリクス基板 220 の表面に第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v が存在しており、同様に、対向基板 240 表面に第 2 ポリイミド p 2 およびポリビニル化合物 p v が存在していることがわかる。

40

#### 【0102】

また、PSA 技術では、配向膜を備えた液晶パネルを作製した後で光を照射して重合体

50

を形成しているが、本実施形態の液晶表示装置 200 では、第 1、第 2 配向膜 110、120 がポリビニル化合物 p v を含有しており、アクティブマトリクス基板 220 と対向基板 240 とを貼り合わせる前に、ポリビニル化合物 p v が形成されている。このため、アクティブマトリクス基板 220 および対向基板 240 を貼り合わせる場所がアクティブマトリクス基板 220 や対向基板 240 を作製した場所と異なる場合でも、貼り合わせる場所においてポリビニル化合物の形成を行わなくてもよく、液晶表示装置 200 を簡便に製造することができる。

#### 【0103】

また、P S A 技術では、液晶層中に未反応のモノマーが残存すると、電圧保持率が低下してしまう。このため、P S A 技術では、残存モノマーを減少させるためには、紫外線を長時間照射させる必要がある。これに対して、本実施形態の液晶表示装置 200 では、プレチルト角の変化を抑制する重合体を配向膜に形成しているため、電圧保持率の低下を抑制するとともに紫外線の長時間照射を省略することができる。

10

#### 【0104】

本実施形態の液晶表示装置 200 では、上述したように、配向膜 110、120 がポリビニル化合物 p v を含有しており、これにより、液晶分子 262 のプレチルト方向が固定化される。これは、ポリビニル化合物 p v により、プレチルト角発現成分の変形が抑制され、その結果、第 2 ポリイミド p 2 による液晶分子 262 の配向方向は、配向膜 110、120 の主面に対しほぼ垂直方向に維持されるからと考えられる。また、ポリビニル化合物 p v により、配向処理時における損傷によって発生した不純物などが固定されて不純物イオンの発生が抑制され焼き付きの発生が抑制される。

20

#### 【0105】

本実施形態の液晶表示装置 200 では、配向膜材料に上記一般式 (1) で示すビニル系モノマーを導入し、通常の方法で成膜することによって、ビニル系モノマーの重合によって形成されたポリビニル化合物 p v が第 1、第 2 配向膜 110、120 の液晶層 260 側に存在する。このため、液晶分子 262 のプレチルト角を安定化させることができ、電圧保持率を高く、また残留 D C 電圧が低く維持されるので焼き付きが防止される。また、P S A 技術とは異なり、液晶材料を付与した後に光重合を行う必要がないため、簡便な工程で製造でき、液晶材料に残存したモノマーによる電圧保持率の低下の問題も生じない。

30

#### 【0106】

なお、参考のために、ビニルモノマーを添加することなく、第 1 ポリイミドと、側鎖にフッ素基を有する第 2 ポリイミドとを混合した配向膜材料を用いて形成した配向膜を X 線電子分光法 (X - r a y P h o t o e l e c t r o n S p e c t r o s c o p y : X P S) で測定した結果を図 3 に示す。配向膜内においてフッ素基は表面近傍に存在していることから、第 2 ポリイミドは第 1 ポリイミドよりも配向膜表面に存在していることが理解される。

30

#### 【0107】

残留 D C 電圧の抑制の観点からは、配向膜 110、120 が高抵抗であることが好ましい。配向膜 110、120 が高抵抗であると、画素電極 224 と対向電極 244 との間の電圧に対して配向膜 110、120 に印加される電圧が増大し、液晶層 260 に印加される電圧が減少し、液晶層 260 と配向膜 110、120 との界面に蓄積される不純物濃度が減少するからである。配向膜 110、120 のうち、特に残留 D C 電圧の抑制に主として寄与する第 1 配向層 112、122 の抵抗が高いことが特に好ましい。

40

#### 【0108】

以下、図 4 を参照して、液晶表示装置 200 の製造方法を説明する。

#### 【0109】

まず、図 4 ( a ) に示すように、第 1 絶縁基板 222 上に画素電極 224 を形成する。なお、図 4 ( a ) には図示していないが、第 1 絶縁基板 222 と画素電極 224 との間には、T F T およびそれらに接続された配線等が設けられている。次に、画素電極 224 を覆う第 1 配向膜 110 を形成する。

50

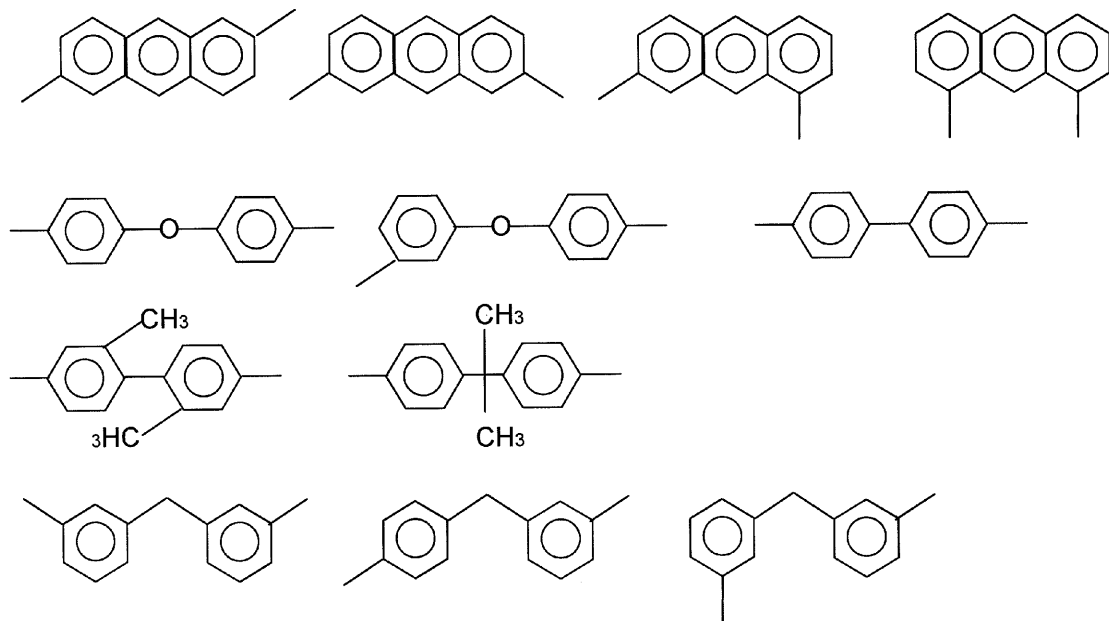
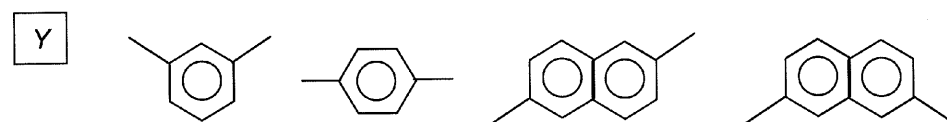
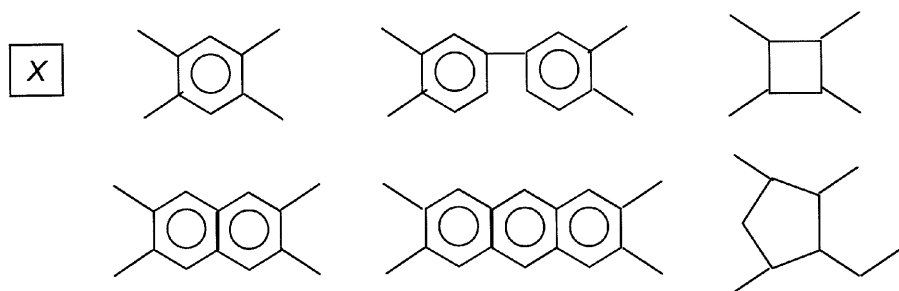
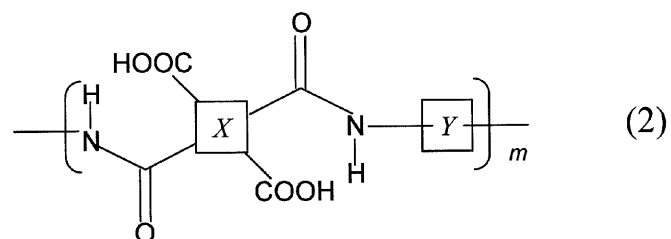
【 0 1 1 0 】

第1配向膜110の形成は以下のように行われる。まず、配向膜材料を用意する。配向膜材料は、第1ポリイミドp1の前駆体と、第2ポリイミドp2およびその前駆体の少なくとも一方と、ビニル系モノマーとを含む溶媒に溶解させたもの（混合物）である。

【 0 1 1 1 】

例えば、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は一般式 ( 2 ) で表される。

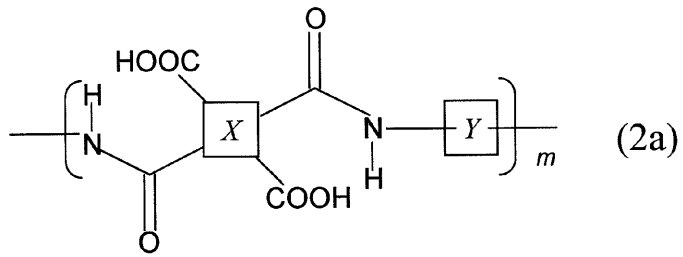
【化 1 3】



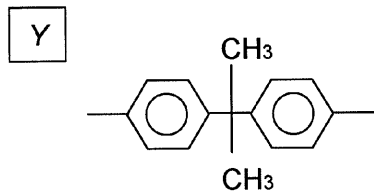
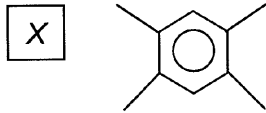
【 0 1 1 2 】

さらに具体的には、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 ( 2 a ) で表される。

【化 1 4】



10

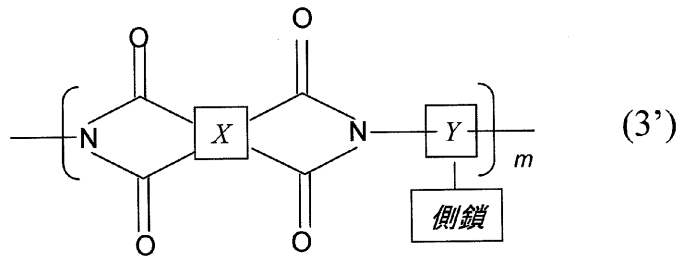


20

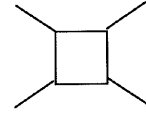
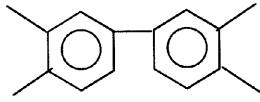
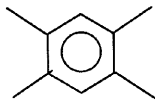
【 0 1 1 3】

例えば、第 2 ポリイミド p 2 は一般式 ( 3 ' ) で表される。

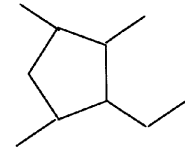
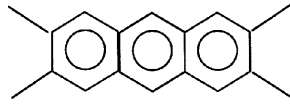
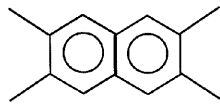
【化 1 5】



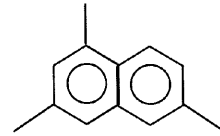
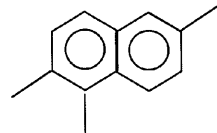
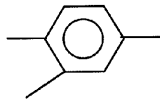
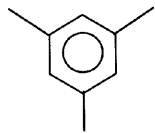
X



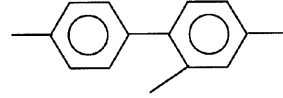
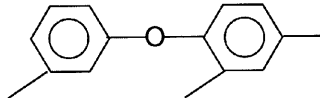
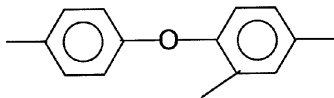
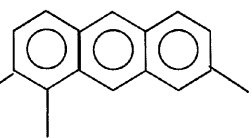
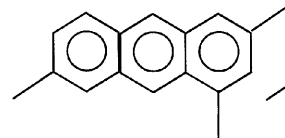
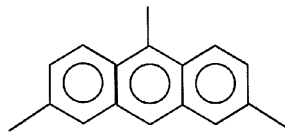
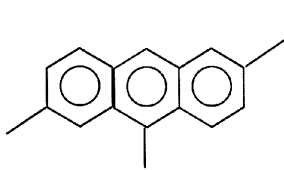
10



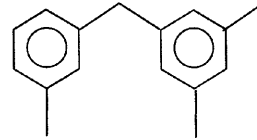
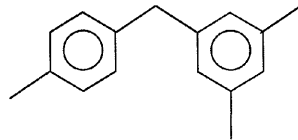
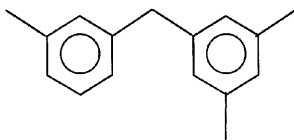
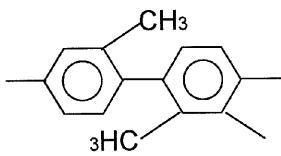
Y



20



30

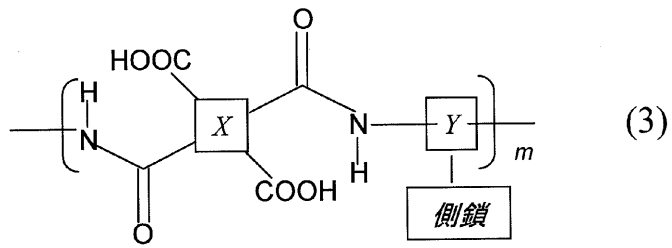


40

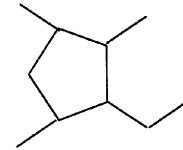
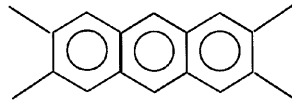
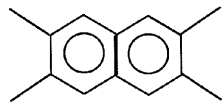
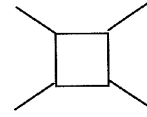
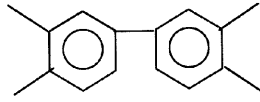
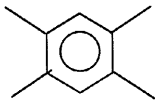
【 0 1 1 4】

また、第 2 ポリイミド p 2 の前駆体（ポリアミック酸）は一般式（3）で表される。

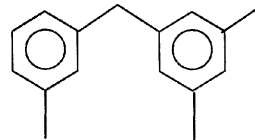
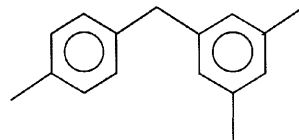
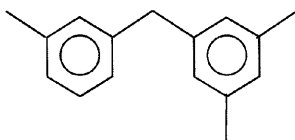
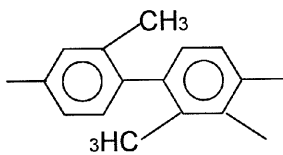
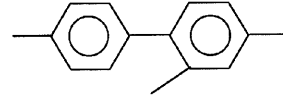
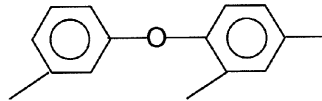
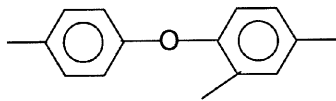
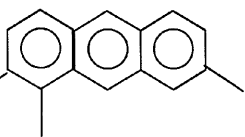
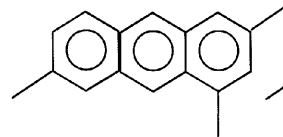
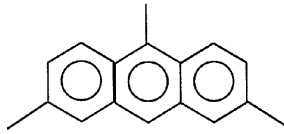
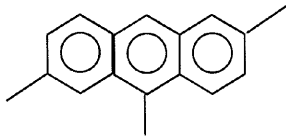
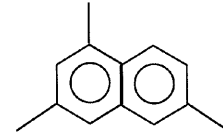
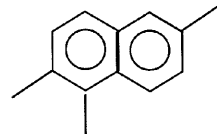
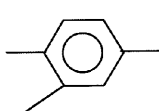
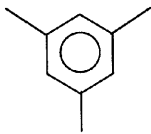
【化 1 6】



X



Y



10

20

30

40

【 0 1 1 5】

また、第 2 ポリイミド p 2 および / またはその前駆体の側鎖は一般式 ( 4 ) で表される。

$$S^3 - D - \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} - \text{F} \\ | \\ \text{F} \end{array} - \text{A} - \left[ S^1 - C^1 \right]_{n^1} - \left[ S^2 - C^2 \right]_{n^2} - B \quad (4)$$

10

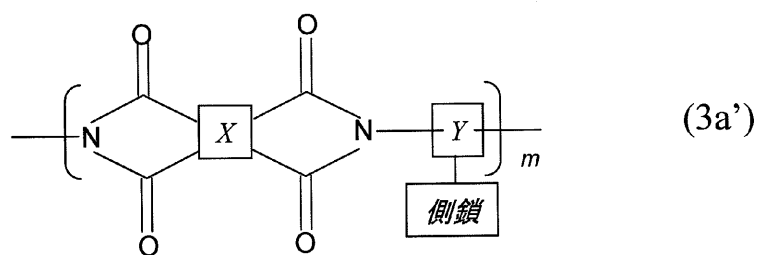
20

30

40

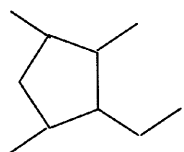
また、第2ポリイミドp2は、光反応性官能基としてシンナメート基を有してもよい。この場合、光照射により、側鎖には二量化サイトが形成される。具体的には、第2ポリイミドp2は式(3a')で表される。

【化 1 8】

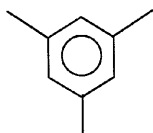


10

X

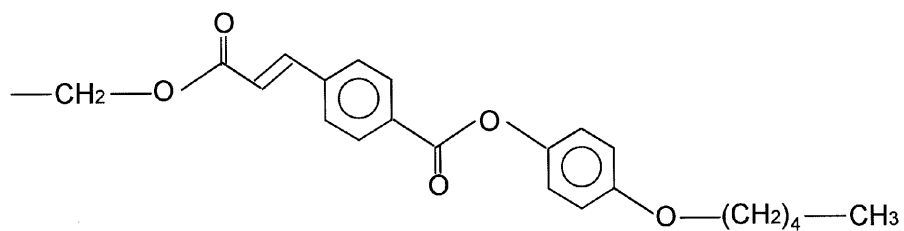


Y



20

側鎖

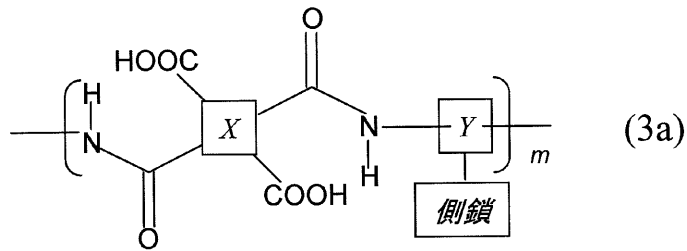


30

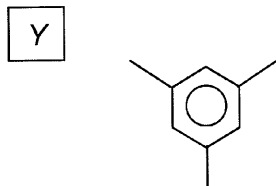
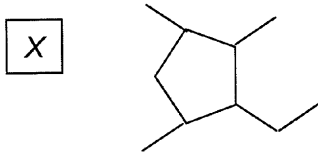
【 0 1 2 4】

また、この前駆体は式 ( 3 a ) で表される。

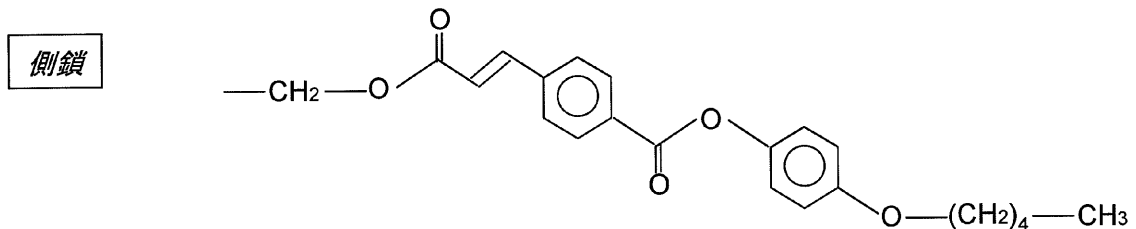
## 【化 1 9】



10



20



30

## 【0 1 2 5】

なお、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体との割合は、重量比で 50% : 50% ~ 80% : 20% 程度である。なお、ビニル系モノマーは、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体ならびに第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体と共有結合を形成するものではない。

## 【0 1 2 6】

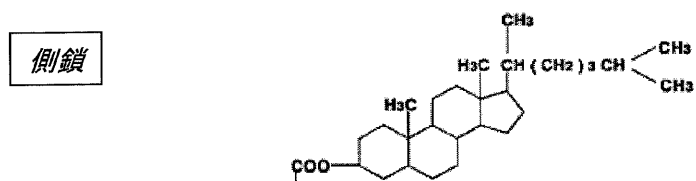
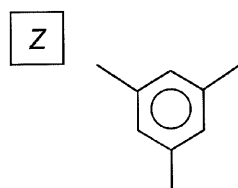
このように、配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体（ポリアミック酸）ならびに第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体（ポリアミック酸）を含有している。なお、ここでは、第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体は構造式（3 a'）、（3 a）に示したように、光反応性官能基を有しているのに対して、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式（2 a）に示したように光反応性官能基を有していない。

40

## 【0 1 2 7】

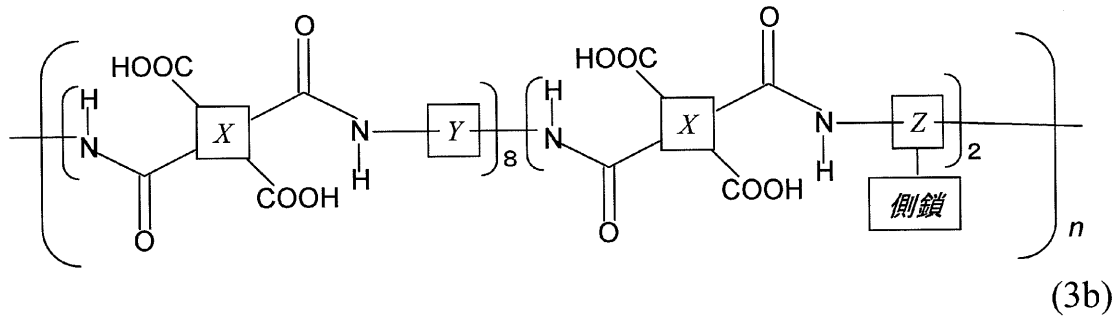
あるいは、第 2 ポリイミド p 2 は側鎖に垂直配向性基を有していてもよい。例えば、第 2 ポリイミド p 2 の前駆体は構造式（3 b'）で表される。

10

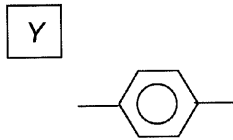
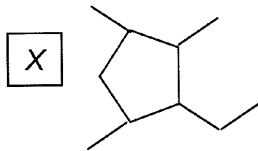


また、第 2 ポリイミド p 2 の前駆体は構造式 ( 3 b ) で表される。

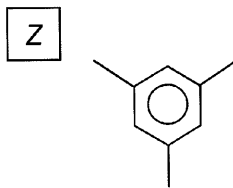
## 【化 2 1】



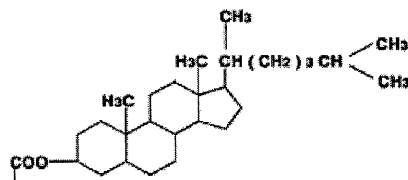
10



20



30



## 【0129】

また、配向膜材料において、例えば、第2ポリイミドp2のイミド化率はおよそ50%であるが、配向膜材料において第1ポリイミドp1はイミド化されておらず、前駆体のままであり、そのイミド化率は0%である。

## 【0130】

40

なお、仮に、ビニル系モノマーを混合することなく配向膜材料を印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で電極上に塗布して配向膜を形成すると、第1ポリイミドを主成分とする第1配向層が下側に形成され、第2ポリイミドを主成分とする第2配向層が上側（液晶層側）に形成される。

## 【0131】

本実施形態では、上述したように、配向膜材料はビニル系モノマーを含有している。ビニル系モノマーは、例えば、2以上の直接結合された環構造または1以上の縮環構造を有していてもよい。例えば、ビニル系モノマーとして、メタクリレート系モノマー、アクリレート系モノマー、メタクリルアミド系モノマーまたはアクリルアミド系モノマーが用いられる。

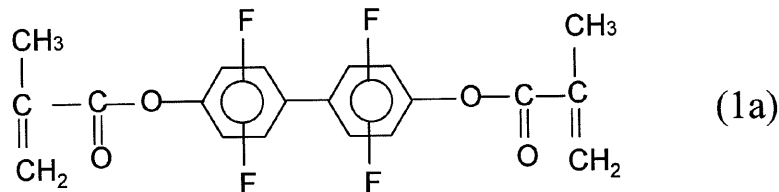
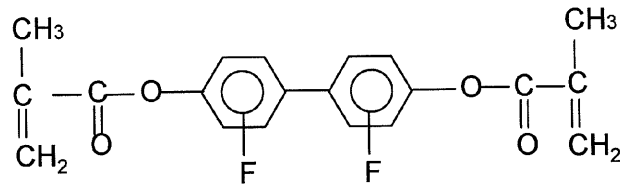
50

## 【 0 1 3 2 】

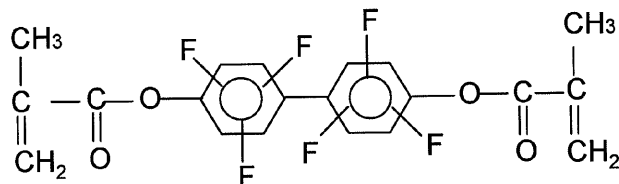
ビニル系モノマーは一般式(1)  $P1 - A1 - (Z1 - A2)_n - P2$  (一般式(1)において、 $P1$ および $P2$ は、独立に、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミドであり、 $A1$ および $A2$ は、独立に、1,4-フェニレン、1,4-シクロヘキサンまたは2,5-チオフェン、もしくは、ナフタレン-2,6-ジイルまたはアントラセン-2,7-ジイルを表し、 $A1$ および $A2$ の少なくとも一方は少なくとも1個のフッ素基で置換されており、 $Z1$ は  $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-O-$ 、 $-CONH-$  基または単結合であり、 $n$ は0または1である)で表される。例えば、ビニル系モノマーは構造式(1a)で表される。

## 【 化 2 2 】

10



20



30

## 【 0 1 3 3 】

ここでは、モノマーは、2つのベンゼン環に対称に結合されたフッ素基を有している。

## 【 0 1 3 4 】

また、溶媒は、例えば、 $\gamma$ -ブチロラクトンおよびN-メチルピロリドン(N-methylpyrrolidone: NMP)を含有している。配向膜材料に対するビニル系モノマーの濃度は、例えば2wt%以上20wt%以下である。

40

## 【 0 1 3 5 】

次に、画素電極224の上に配向膜材料を塗布し、加熱処理を行うことによって第1配向膜110を形成する。加熱処理として、例えば、異なる温度で2回の加熱処理が行われてもよい。具体的には、第1加熱処理を行った後に、第1加熱処理よりも高温で第2加熱処理が行われる。第1加熱処理により、溶媒の大部分は除去される。以下の説明において、溶媒が実質的に除去されたものも配向膜と呼ぶ。また、その後の第2加熱処理により、イミド化および重合が進行し、配向膜は安定化する。第1加熱処理は仮焼成とも呼ばれ、第2加熱処理は本焼成とも呼ばれる。加熱処理により、ポリアミック酸はイミド化して第1、第2ポリイミドp1、p2が形成される。

## 【 0 1 3 6 】

50

また、加熱処理により、ビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物 p v が形成される。このようにして第 1 配向膜 1 1 0 が形成される。ポリビニル化合物 p v は、フッ素基を含有しており、第 1 配向膜 1 1 0 の表面およびその近傍に存在している。なお、ポリビニル化合物 p v は、第 1 ポリイミド p 1 および第 2 ポリイミド p 2 と共有結合を形成するものではない。

#### 【 0 1 3 7 】

なお、加熱処理により、第 1、第 2 ポリイミド p 1、p 2 のそれぞれのイミド化率は増大する。例えば、第 2 ポリイミド p 2 のイミド化率はおよそ 70 % ~ 80 % であり、第 1 ポリイミド p 1 のイミド化率はおよそ 40 % ~ 50 % である。このように、加熱処理後も、第 2 ポリイミド p 2 のイミド化率は第 1 ポリイミド p 1 のイミド化率よりも高い。

10

#### 【 0 1 3 8 】

次に、第 1 配向膜 1 1 0 に対して配向処理を行う。配向処理は、第 1 加熱処理後に行われてもよいし、第 2 加熱処理後に行われてもよい。配向処理は、例えば、第 1 配向膜 1 1 0 に対して光を照射することによって行われる。例えば、波長 250 nm 以上 400 nm 以下の範囲内の光が  $20 \text{ mJ} / \text{cm}^2$  以上  $200 \text{ mJ} / \text{cm}^2$  以下の照射量で、第 1 配向膜 1 1 0 の主面の法線方向から傾いた方向から第 1 配向膜 1 1 0 に照射される。なお、照射量が  $200 \text{ mJ} / \text{cm}^2$  よりも増大すると配向膜が劣化し電圧保持率等が低下することがある。また、光の照射角度は第 1 配向膜 1 1 0 の主面の法線方向から  $5^\circ$  以上  $85^\circ$  以下の範囲であればよく、また、 $40^\circ$  以上  $60^\circ$  以下であることが好ましい。なお、照射角度が小さいとプレチルト角が付与されにくく、照射角度があまり大きいと同じプレチルト

20

#### 【 0 1 3 9 】

図 4 ( b ) に示すように、第 2 絶縁基板 2 4 2 上に対向電極 2 4 4 を形成する。また、配向膜材料を用意する。この配向膜材料は、第 1 配向膜 1 1 0 と同様のものであってもよい。

#### 【 0 1 4 0 】

次に、対向電極 2 4 4 の上に配向膜材料を塗布し、加熱処理を行うことによって第 2 配向膜 1 2 0 を形成する。加熱処理として、例えば、異なる温度で 2 回の加熱処理が行われてもよい。加熱処理により、溶媒の蒸発およびイミド化によって第 1、第 2 ポリイミド p 1、p 2 が形成されるとともに、ビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物 p v が形成される。次に、このように形成された第 2 配向膜 1 2 0 に対して配向処理を行う。配向処理は、第 1 配向膜 1 1 0 と同様に行われる。

30

#### 【 0 1 4 1 】

次に、図 4 ( c ) に示すように、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 が向かい合うようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせる。本明細書において、液晶層を形成する前に、アクティブマトリクス基板および対向基板を貼り合わせたものを「空パネル」とも呼ぶ。

40

#### 【 0 1 4 2 】

次に、液晶材料を用意し、空パネルの第 1 配向膜 1 1 0 と第 2 配向膜 1 2 0 との間に液晶材料を付与し、液晶層 2 6 0 を形成する。上述したように、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 には配向処理が行われており、液晶分子 2 6 2 は、電圧無印加時にも第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の主面の法線方向から傾くように配向している。また、ポリビニル化合物 p v は液晶分子 2 6 2 の配向を維持しており、結果として、焼き付きが抑制される。このようにして液晶パネル 3 0 0 が形成される。その後、液晶パネル 3 0 0 に、図 2 ( a ) に示した駆動回路 3 5 0、制御回路 3 6 0 を実装し、液晶表示装置 2 0 0 が作製される。

#### 【 0 1 4 3 】

50

なお、上述した P S A 技術では、電圧を印加した状態で重合体を形成している。このように電圧を印加しながら、重合体を形成するための紫外線を照射する場合、液晶パネルに電圧を印加するデバイスと紫外光を照射するデバイスとが一体化された複雑な製造装置が必要となる。また、所定の配向を得るために、液晶パネルに電圧を長時間印加した後で紫外光を照射するため、この製造装置を長時間使用する必要がある。また、液晶材料を滴下することによって液晶パネルの液晶層を形成する場合、一般に、大型のマザーガラス基板を用いて複数個の液晶パネルを同時に作製した後、大型のマザーガラス基板を分断して各液晶パネルを取り出す。このように複数個の液晶パネルを同時に作製する場合、複数個の液晶パネルに同時に電圧を印加するためにマザーガラス基板上に特殊な配線を形成するように設計する必要がある。

10

**【 0 1 4 4 】**

また、特にサイズの大きい液晶パネルを作製する場合、各画素の液晶層に電圧を均一に印加することは困難であり、不均一な電圧を印加した状態で紫外光の照射を行うと、プレチルト角がばらついてしまう。

**【 0 1 4 5 】**

また、重合体の形成時に電圧を印加する場合、視野角特性の改善を行うために、画素電極および対向電極にリブ、スリットまたはリベットを設けることが必要となるが、その結果、工程数が増大するとともに実質的な開口率が低下する。

**【 0 1 4 6 】**

これに対して、本実施形態ではポリビニル化合物 p v の形成時に電圧を印加しない。したがって、複雑な製造装置を用いなくても液晶表示装置 2 0 0 を容易に製造することができる。また、液晶材料を滴下して液晶層 2 6 0 を形成する場合でも液晶パネルを容易に作製することができる。また、ポリビニル化合物 p v の形成時に、すべての画素の液晶層 2 6 0 に電圧を印加しなくてもよい。また、液晶分子 2 6 2 のプレチルト角の変化を抑制することができる。さらに、画素電極 2 2 4 および対向電極 2 4 4 にリブ、スリットまたはリベットを設けることなく視野角の改善を行うことができ、工程の増加を抑制することができる。

20

**【 0 1 4 7 】**

ただし、画素電極 2 2 4 および対向電極 2 4 4 にスリット、リブおよび / またはリベットを設けてもよい。あるいは、画素電極 2 2 4 および対向電極 2 4 4 にスリット、リブおよび / またはリベットが設けられていなくてもよく、対向電極 2 4 4 と対称性の高い画素電極 2 2 4 とによって形成される斜め電界に従って液晶分子 2 6 2 を配向させてもよい。これにより、電圧印加時における液晶分子 2 6 2 の配向規制力をさらに増大させることができる。

30

**【 0 1 4 8 】**

なお、上述した説明では、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 は同じ配向膜材料から形成されたが、本発明はこれに限定されない。第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 は異なる配向膜材料から形成されてもよい。例えば、第 1 配向膜 1 1 0 の第 1、第 2 ポリイミド p 1、p 2 およびポリビニル化合物 p v の少なくとも 1 つは、第 2 配向膜 1 2 0 の第 1、第 2 ポリイミド p 1、p 2 およびポリビニル化合物 p v の少なくとも 1 つと異なってもよい。

40

**【 0 1 4 9 】**

また、上述した説明では、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 はポリビニル化合物 p v をそれぞれ含有していたが、本発明はこれに限定されない。第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の一方のみが対応するポリビニル化合物 p v を含有してもよい。

**【 0 1 5 0 】**

また、上述した説明では、アクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 が第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 をそれぞれ有していたが、本発明はこれに限定されない。アクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 の一方のみが、対応する第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 を有していてもよい。

**【 0 1 5 1 】**

50

なお、上述した説明では、ポリビニル化合物 p v は、加熱処理によって形成されたが、本発明はこれに限定されない。ポリビニル化合物 p v は、光の照射によって形成されてもよい。例えば、この光照射では、波長 365 nm の紫外光 ( i 線 ) を主に射出する光源が好適に用いられる。照射時間は、例えば約 500 秒であり、光の照射強度は約 20 mW / cm<sup>2</sup> である。光を照射して重合を行う場合、光の照射強度が 10 mW / cm<sup>2</sup> 以下であっても多官能モノマーは十分に重合する。光の波長は 250 nm 以上 400 nm 以下の範囲内であることが好ましく、波長は 300 nm 以上 400 nm 以下の範囲内であることがさらに好ましい。しかしながら、400 nm よりも大きい波長の光でも重合は充分に行われる。また、波長 300 nm 以下の光でも重合を行うことができるが、波長 200 nm 近傍の深紫外線を照射すると有機物の分解が起こるので、照射量をできるだけ少なくすることが好ましい。

10

#### 【0152】

また、液晶表示装置 200 は、4D RTN ( 4 Domain Reverse Twisted Nematic ) モードであってもよい。以下、図 5 を参照して 4D RTN モードの液晶表示装置を説明する。

#### 【0153】

図 5 ( a ) には、アクティブマトリクス基板 220 の配向膜 110 に規定された液晶分子のプレチルト方向 PA1 および PA2 を示しており、図 5 ( b ) には、対向基板 240 の配向膜 120 に規定された液晶分子のプレチルト方向 PB1 および PB2 を示している。図 5 ( c ) には、電圧印加状態において液晶ドメイン A ~ D の中央の液晶分子の配向方向、および、配向乱れによって暗く見える領域 ( ドメインライン ) DL1 ~ DL4 を示している。なお、ドメインライン DL1 ~ DL4 は、いわゆるディスクリネーションラインではない。

20

#### 【0154】

図 5 ( a ) ~ 図 5 ( c ) には、観察者側から見たときの液晶分子の配向方向を模式的に示している。図 5 ( a ) ~ 図 5 ( c ) では、円柱状の液晶分子の端部 ( ほぼ円形部分 ) が観察者に向かうようにチルトしていることを示している。

#### 【0155】

図 5 ( a ) に示すように、第 1 配向膜 110 は、第 1 配向領域 OR1 と第 2 配向領域 OR2 とを有している。第 1 配向領域 OR1 に規定された液晶分子は、第 1 配向膜 110 の主面の法線方向から - y 方向に傾いており、第 1 配向膜 110 の第 2 配向領域 OR2 に規定された液晶分子は、第 1 配向膜 110 の主面の法線方向から + y 方向に傾いている。また、第 1 配向領域 OR1 と第 2 配向領域 OR2 の境界線は、列方向 ( y 方向 ) に延びており、画素の行方向 ( x 方向 ) の略中心に位置している。このように、第 1 配向膜 110 には、プレチルト方位の異なる第 1、第 2 配向領域 OR1、OR2 が設けられている。

30

#### 【0156】

また、図 5 ( b ) に示すように、第 2 配向膜 120 は、第 3 配向領域 OR3 と第 4 配向領域 OR4 とを有している。第 3 配向領域 OR3 に規定された液晶分子は第 2 配向膜 120 の主面の法線方向から + x 方向に傾いており、この液晶分子の - x 方向の端部が前面側に向いている。また、第 2 配向膜 120 の第 4 配向領域 OR4 に規定された液晶分子は第 2 配向膜 120 の主面の法線方向から - x 方向に傾いており、この液晶分子の + x 方向の端部が前面側に向いている。このように、第 2 配向膜 120 には、プレチルト方位の異なる第 3、第 4 配向領域 OR3、OR4 が設けられている。

40

#### 【0157】

配向処理方向は、液晶分子の長軸に沿って配向領域に向かう方向をその配向領域に投影した方位角成分と対応している。第 1、第 2、第 3 および第 4 配向領域の配向処理方向をそれぞれ第 1、第 2、第 3 および第 4 配向処理方向とも呼ぶ。

#### 【0158】

第 1 配向膜 110 の第 1 配向領域 OR1 には、第 1 配向処理方向 PD1 に配向処理が行われおり、第 2 配向領域 OR2 には、第 1 配向処理方向 PD1 とは異なる第 2 配向処理方

50

向 P D 2 に配向処理が行われている。第 1 配向処理方向 P D 1 は第 2 配向処理方向 P D 2 とほぼ反平行である。また、第 2 配向膜 1 2 0 の第 3 配向領域 O R 3 には、第 3 配向処理方向 P D 3 に配向処理が行われおり、第 4 配向領域 O R 4 には、第 3 配向処理方向 P D 3 とは異なる第 4 配向処理方向 P D 4 に配向処理が行われている。第 3 配向処理方向 P D 3 は第 4 配向処理方向 P D 4 とほぼ反平行である。

【 0 1 5 9 】

図 5 ( c ) に示すように、画素の液晶層には 4 つの液晶ドメイン A、B、C および D が形成される。液晶層 2 6 0 のうち、第 1 配向膜 1 1 0 の第 1 配向領域 O R 1 と第 2 配向膜 1 2 0 の第 3 配向領域 O R 3 とに挟まれる部分が液晶ドメイン A となり、第 1 配向膜 1 1 0 の第 1 配向領域 O R 1 と第 2 配向膜 1 2 0 の第 4 配向領域 O R 4 とに挟まれる部分が液晶ドメイン B となり、第 1 配向膜 1 1 0 の第 2 配向領域 O R 2 と第 2 配向膜 1 2 0 の第 4 配向領域 O R 4 とに挟まれる部分が液晶ドメイン C となり、第 1 配向膜 1 1 0 の第 2 配向領域 O R 2 と第 2 配向膜 1 2 0 の第 3 配向領域 O R 3 とに挟まれる部分が液晶ドメイン D となる。なお、第 1、第 2 配向処理方向 P D 1、P D 2 と第 3、第 4 配向処理方向 P D 3、P D 4 とのなす角度はほぼ 90° であり、各液晶ドメイン A、B、C、D におけるねじれ角はほぼ 90° である。

【 0 1 6 0 】

液晶ドメイン A ~ D の中央の液晶分子の配向方向は、第 1 配向膜 1 1 0 による液晶分子のプレチルト方向と第 2 配向膜 1 2 0 による液晶分子のプレチルト方向との中間の方向となる。本明細書において、液晶ドメインの中央における液晶分子の配向方向を基準配向方向と呼び、基準配向方向のうち液晶分子の長軸に沿って背面から前面に向かう方向の方位角成分（すなわち、基準配向方向を第 1 配向膜 1 1 0 または第 2 配向膜 1 2 0 の主面に投影した方位角成分）を基準配向方位と呼ぶ。基準配向方位は、対応する液晶ドメインを特徴付けており、各液晶ドメインの視野角特性に支配的な影響を与える。ここで、表示画面（紙面）の水平方向（左右方向）を方位角方向の基準とし、左回りに正をとる（表示面を時計の文字盤に例えると 3 時方向を方位角 0° として、反時計回りを正とする）と、4 つの液晶ドメイン A ~ D の基準配向方向は任意の 2 つの方向の差が 90° の整数倍に略等しい 4 つの方向となるように設定されている。具体的には、液晶ドメイン A、B、C、D の基準配向方位は、それぞれ、225°、315°、45°、135° である。

【 0 1 6 1 】

図 5 ( c ) に示すように、液晶ドメイン A、B、C、D にドメインライン D L 1 ~ D L 4 がそれぞれ形成される。画素電極 2 2 4 のエッジ部 E G 1 の一部と平行にドメインライン D L 1 が生じ、エッジ部 E G 2 の一部と平行にドメインライン D L 2 が形成される。また、画素電極 2 2 4 のエッジ部 E G 3 の一部と平行にドメインライン D L 3 が形成され、エッジ部 E G 4 の一部と平行にドメインライン D L 4 が形成される。また、液晶ドメイン A ~ D のそれぞれが他の液晶ドメインと隣接する境界領域に、破線で示したディスクリネーションライン C L が観察される。ディスクリネーションライン C L は、上述した中央部の暗線である。ディスクリネーションライン C L とドメインライン D L 1 ~ D L 4 とは連続的であり、逆 U 状の暗線が発生している。なお、ここでは、暗線は逆 U 状であったが、暗線は 8 の字状であってもよい。

【 0 1 6 2 】

また、上述した液晶表示装置は 4 D - R T N モードであったが、本発明はこれに限定されない。液晶表示装置は C P A モードであってもよい。

【 0 1 6 3 】

また、上述した説明では、配向膜は 2 層の配向層を有しているが、本発明はこれに限定されない。配向膜は 3 層以上の配向層を有していてもよい。

【 0 1 6 4 】

以下、本実施例の配向膜および液晶表示装置を説明する。

【 0 1 6 5 】

[ 実施例 1 ]

## (実施例 1 - 1)

以下、図 2 および図 6 を参照して、実施例 1 - 1 の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例 1 - 1 の液晶表示装置も R T N モードで動作する。

## 【0166】

まず、第 1 絶縁基板 222 の主面の上に、図示しないが、T F T および T F T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 224 を形成した。同様に、第 2 絶縁基板 242 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 244 を形成した。

## 【0167】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーをさらに添加することによって形成された。第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 (2 a) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミド p 2 は構造式 (3 a') に示す光配向性ポリイミドであった。第 2 ポリイミドのイミド化率はおよそ 50 % であった。ビニル系モノマーとして、構造式 (1 a) に示すピフェニルジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して 10 wt % であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が 2、4 および 6 の 3 種類の配向膜材料を用意した。また、比較のために、モノマーあたりのフッ素基の数が 0 の配向膜材料も用意した。

## 【0168】

次に、配向膜材料を画素電極 224 上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第 1 加熱処理 (仮焼成) として 90 で 1 分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第 2 加熱処理 (本焼成) として 200 で 40 分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化し、第 1 ポリイミド p 1 を含む第 1 配向層 112 および第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 114 が形成された。このようにして、画素電極 224 上に第 1 配向膜 110 が形成された。

## 【0169】

その後、第 1 配向膜 110 の主面の法線方向に対して斜め 40 ° 方向から、ピーク波長 330 nm の P 偏光を 50 mJ / cm<sup>2</sup> 照射することにより、光配向処理を行った。同様に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極 244 上に第 2 配向膜 120 を形成し、光配向処理を行った。なお、第 1、第 2 配向膜 110、120 を分析したところ、構造式 (1 a) に示すジメタクリレートは重合しており、配向膜表面にもポリビニル化合物 p v は存在していた。

## 【0170】

次に、第 1 配向膜 110 および第 2 配向膜 120 が互いに対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が 90 ° となるようにアクティブマトリクス基板 220 および対向基板 240 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 220 と対向基板 240 との間隔が 4 μm 程度になるように固定した。

## 【0171】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 220 と対向基板 240 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は -3、複屈折率 n が 0.085 であった。

## 【0172】

図 6 (a) に、実施例 1 - 1 の液晶表示装置における液晶分子 262 の配向状態を示す。図 6 (b) に示すように、第 1 配向膜 110 の配向処理方向 P D 1 と第 2 配向膜 120 の配向処理方向 P D 3 とのなす角が 90 ° となるようにアクティブマトリクス基板 220 および対向基板 240 を貼り合わせており、液晶分子 262 のねじれ角は 90 ° であった。なお、ここでは、アクティブマトリクス基板 220 の偏光板の偏光軸が第 1 配向膜 110 の配向処理方向と平行であり、対向基板 240 の偏光板の偏光軸が第 2 配向膜 120 の配向処理方向と平行であった。このようにして液晶パネルを作製した。表 1 に、モノマー

あたりのフッ素基の数とプレチルト角との関係を示す。

【 0 1 7 3 】

【表 1】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角 (°)	87.7	87.2	87.0	86.9

【 0 1 7 4 】

表 1 から理解されるように、フッ素基の数が増加するほど、プレチルト角は低下する。

【 0 1 7 5 】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧 ± 10 V を 50 時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表 2 に、その結果を示す。

【 0 1 7 6 】

【表 2】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角 (°)	87.7	87.2	87.0	86.9
チルト角変化量 (°)	0.12	0.05	0.04	0.04

【 0 1 7 7 】

表 2 から理解されるように、モノマーがフッ素基を有していることにより、チルト角変化量が抑制されている。これは、フッ素基により、第 1、第 2 配向膜 110、120 の表面に存在するビニル系モノマーまたはポリビニル化合物 p v の密度が高くなり、ポリビニル化合物 p v と液晶分子 262 との相互作用により、液晶分子 262 のチルト角変化が抑えられたと考えられる。なお、チルト角変化量が 0.10° を超えると、焼き付きが顕著になる傾向がある。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は 99.5% 以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

【 0 1 7 8 】

実施例 1 - 1 の液晶表示装置では、MVA モードのようにリブやスリットを設けておらず高開口率を実現できた。また、重合時に電圧を印加しないため、複雑な製造装置を用いることなく、実施例 1 - 1 の液晶表示装置を製造することができた。

【 0 1 7 9 】

( 実施例 1 - 2 )

以下、図 2 および図 6 を参照して、実施例 1 - 2 の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例 1 - 2 の液晶表示装置も RTN モードで動作する。

【 0 1 8 0 】

まず、第 1 絶縁基板 222 の主面の上に、図示しないが、TF T および TF T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 224 を形成した。同様に、第 2 絶縁基板 242 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 244 を形成した。

【 0 1 8 1 】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 ( 2 a ) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミド p 2 は構造式 ( 3 a ' ) に示す光配向性ポリイミドであった。第 2 ポリイミド p 2 のイミド化率はおよそ 50% であった。ビニル系モノマーとして、式 ( 1 a ) に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して 10 wt% であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が 2、4 および 6 の 3 種類の配向膜材料を用意した。また、比較のために、モノマーあたりのフッ素基の数が 0 の配向膜材料も用意し

10

20

30

40

50

た。

#### 【 0 1 8 2 】

次に、配向膜材料を画素電極 2 2 4 上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第 1 加熱処理（仮焼成）として 9 0 で 1 分間加熱して溶媒をある程度除去した。その後、第 1 配向膜 1 1 0 の主面の法線方向に対して斜め 4 0 ° 方向から、ピーク波長 3 3 0 n m の P 偏光を 5 0 m J / c m<sup>2</sup> 照射することにより、光配向処理を行った。その後、第 2 加熱処理（本焼成）として 1 5 0 で 4 0 分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化し、第 1 ポリイミド p 1 を含む第 1 配向層 1 1 2 および第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 1 1 4 が形成された。このようにして、画素電極 2 2 4 上に第 1 配向膜 1 1 0 を形成した。

10

#### 【 0 1 8 3 】

同様に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極 2 4 4 上に第 2 配向膜 1 2 0 を形成し、光配向処理を行った。なお、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 を分析したところ、式（1 a）に示すジメタクリレートは重合しており、配向膜表面にもポリビニル化合物 p v は存在していた。

#### 【 0 1 8 4 】

次に、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 が互いに対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が 9 0 ° となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間隔が 4 μ m 程度になるように固定した。

20

#### 【 0 1 8 5 】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は - 3、複屈折率 n が 0 . 0 8 5 であった。このようにして液晶パネルを作製した。表 3 に、モノマーあたりのフッ素基の数とプレチルト角との関係を示す。

#### 【 0 1 8 6 】

【表 3】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角 (°)	87.5	87.0	87.0	86.9

30

#### 【 0 1 8 7 】

表 3 から理解されるように、モノマーあたりのフッ素基の数がゼロであるとプレチルト角は大きい、モノマーがフッ素基を有していると、プレチルト角が低下する。なお、光配向処理後の本焼成を 2 0 0 で行くと、全ての条件でプレチルト角は 8 9 . 9 ° 以上になった。

#### 【 0 1 8 8 】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧 ± 1 0 V を 5 0 時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表 4 に、その結果を示す。

#### 【 0 1 8 9 】

【表 4】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角 (°)	87.5	87.0	87.0	86.9
チルト角変化量 (°)	0.10	0.04	0.04	0.04

40

#### 【 0 1 9 0 】

以上の結果から、実施例 1 - 1 と同様に、モノマーがフッ素基を有していることにより、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の表面に存在するモノマーおよびポリビニル化合物の密度は高くなり、チルト角変化が抑えられたと考えられる。なお、通電試験終了後に測定

50

した電圧保持率は99.5%以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

#### 【0191】

(実施例1-3)

以下、図2および図6を参照して、実施例1-3の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例1-3の液晶表示装置もRTNモードで動作する。

#### 【0192】

まず、第1絶縁基板222の主面の上に、図示しないが、TF TおよびTF Tに接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極224を形成した。同様に、第2絶縁基板242の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極244を形成した。

10

#### 【0193】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第1ポリイミドp1の前駆体と、第2ポリイミドp2およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第1ポリイミドp1の前駆体は構造式(2a)に示すポリアミック酸であり、第2ポリイミドp2は構造式(3a')に示す光配向性ポリイミドであった。第2ポリイミドp2のイミド化率はおよそ50%であった。ビニル系モノマーとして、式(1a)に示すジメタクリレートモノマーを添加した。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が4のジメタクリレートモノマーを用いた。なお、その濃度は配向膜材料に対して5、10、15、20および30wt%であった。また、比較のために、ジメタクリレートモノマーの濃度ゼロ(すなわち、ジメタクリレートモノマーを添加していない)の配向膜材料も用意した。

20

#### 【0194】

次に、配向膜材料を画素電極224上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第1加熱処理(仮焼成)として90℃で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第2加熱処理(本焼成)として200℃で40分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化し、第1ポリイミドp1を含む第1配向層112および第2ポリイミドp2を含む第2配向層114が形成された。このようにして、画素電極224上に第1配向膜110が形成された。

30

#### 【0195】

その後、第1配向膜110の主面の法線方向に対して斜め40°方向から、ピーク波長330nmのP偏光を50mJ/cm<sup>2</sup>照射することにより、光配向処理を行った。同様に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極244上に第2配向膜120を形成し、光配向処理を行った。なお、第1、第2配向膜110、120を分析したところ、式(1a)に示すジメタクリレートは重合しており、配向膜表面にもポリビニル化合物pvは存在していた。

#### 【0196】

次に、第1配向膜110および第2配向膜120が互いに対向するとともに第1配向膜の配向処理方向と第2配向膜の配向処理方向とのなす角が90°となるようにアクティブマトリクス基板220および対向基板240を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板220と対向基板240との間隔が4μm程度になるように固定した。

40

#### 【0197】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板220と対向基板240との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は-3、複屈折率nが0.085であった。このようにして液晶パネルを作製した。表5に、ビニル系モノマー濃度とプレチルト角との関係を示す。

#### 【0198】

【表 5】

ビニル系モノマー濃度 (w t %)	0	5	10	15	20	30
プレチルト角 (°)	88.5	87.1	87.0	87.1	87.0	87.0

## 【0199】

表 5 から理解されるように、ビニル系モノマー濃度がゼロであるとプレチルト角は大きい、ビニル系モノマーが導入されると、プレチルト角は低下する。

## 【0200】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧  $\pm 10$  V を 50 時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表 6 に、その結果を示す。

10

## 【0201】

【表 6】

モノマー濃度 (w t %)	0	5	10	15	20	30
プレチルト角 (°)	88.5	87.1	87.0	87.1	87.0	87.0
チルト角変化量 (°)	0.17	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04

## 【0202】

表 6 から理解されるように、配向膜材料に対するモノマーの濃度が 5 w t % 以上である場合、チルト角変化は充分小さく抑えることができる。ただし、モノマーの濃度が 30 w t % 以上となると、配向膜はポリビニル化合物によってやや白濁して見えた。これは、重合性成分の濃度が高すぎたためと考えられる。

20

## 【0203】

なお、配向膜材料に対するモノマー濃度が 30 w t % であってもプレチルト角を安定させる効果があったが、基板の白濁状態が顕著になり、これ以上濃度を上げると散乱によるコントラスト低下が観測された。通電試験終了後に測定した電圧保持率は 99.5 % 以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

## 【0204】

(実施例 1 - 4)

30

以下、図 2 および図 6 を参照して、実施例 1 - 4 の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例 1 - 4 の液晶表示装置も R T N モードで動作する。

## 【0205】

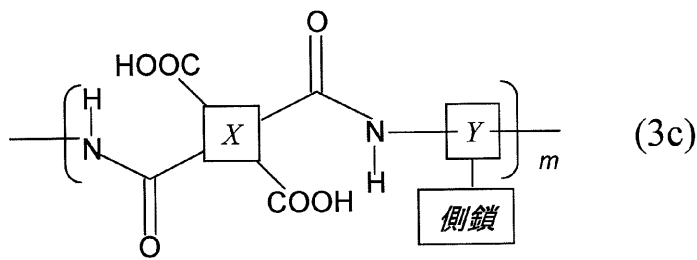
まず、第 1 絶縁基板 222 の主面の上に、図示しないが、T F T および T F T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 224 を形成した。同様に、第 2 絶縁基板 242 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 244 を形成した。

## 【0206】

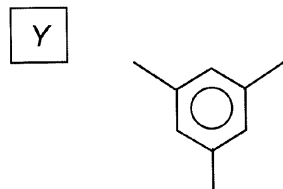
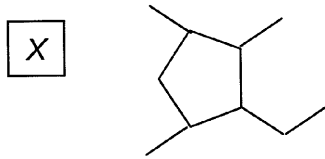
次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 の前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 (2 a) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミド p 2 の前駆体は構造式 (3 c) に示すポリアミック酸であった。

40

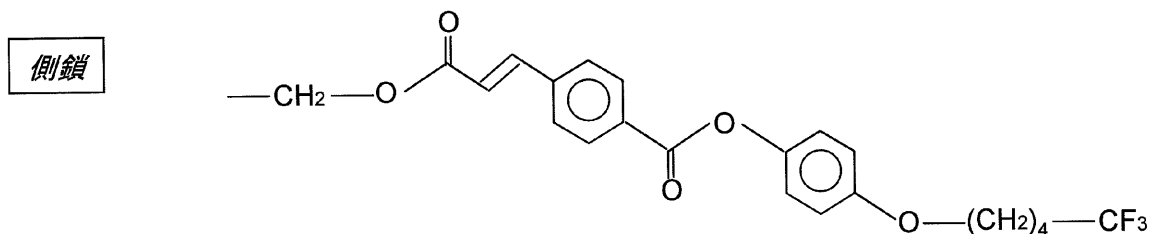
## 【化 2 3】



10



20



30

## 【0207】

ここでは、第2ポリイミドのイミド化率は第1ポリイミドのイミド化率と同様に0%であった。ビニル系モノマーとして、式(1a)に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して10wt%であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が4の配向膜材料を用意した。また、比較のために、モノマーあたりのフッ素基の数が0の配向膜材料も用意した。

40

## 【0208】

次に、配向膜材料を画素電極224上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第1加熱処理(仮焼成)として90℃で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第2加熱処理(本焼成)として200℃で40分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化して第1、第2ポリイミドp1、p2が形成されるとともにビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物pvが形成された。このようにして、画素電極224上に第1配向膜110が形成された。

## 【0209】

その後、第1配向膜110の主面の法線方向に対して斜め40°方向から、ピーク波長330nmのP偏光を50mJ/cm<sup>2</sup>照射することにより、光配向処理を行った。同様

50

に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極 2 4 4 上に第 2 配向膜 1 2 0 を形成し、光配向処理を行った。

【 0 2 1 0 】

次に、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 が互いに対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が  $90^\circ$  となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間隔が  $4\ \mu\text{m}$  程度になるように固定した。

【 0 2 1 1 】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は - 3、複屈折率  $n$  が 0 . 0 8 5 であった。このようにして液晶パネルを作製した。表 7 に、ビニル系モノマー濃度とプレチルト角との関係を示す。

10

【 0 2 1 2 】

【表 7】

フッ素基の数	0	4
プレチルト角 ( $^\circ$ )	87.9	87.3

【 0 2 1 3 】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧  $\pm 10\text{V}$  を 50 時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表 8 に、その結果を示す。

20

【 0 2 1 4 】

【表 8】

フッ素基の数	0	4
プレチルト角 ( $^\circ$ )	87.9	87.3
チルト角変化量 ( $^\circ$ )	0.14	0.09

【 0 2 1 5 】

表 8 から理解されるように、実施例 1 - 1 と同様に、モノマーがフッ素基を有していることにより、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の表面に存在するモノマーおよびポリビニル化合物 p v の密度は高くなり、チルト角変化が抑えられたと考えられる。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は 99 . 5 % 以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

30

【 0 2 1 6 】

( 参考例 )

以下、参考例の配向膜および液晶表示装置を説明する。参考例の液晶表示装置も R T N モードで動作する。

【 0 2 1 7 】

まず、第 1 絶縁基板の主面の上に、T F T および T F T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極を形成した。同様に、第 2 絶縁基板の主面の上に、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極を形成した。

40

【 0 2 1 8 】

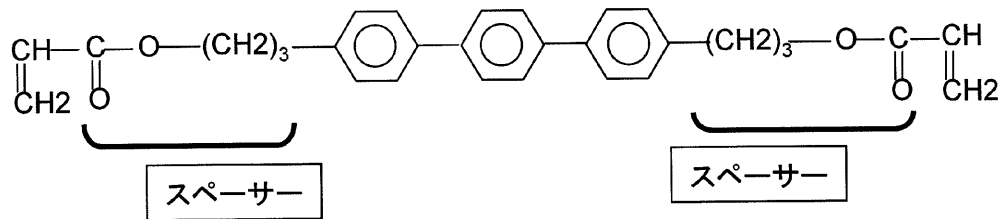
次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第 1 ポリイミドの前駆体と、第 2 ポリイミドおよびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第 1 ポリイミドの前駆体は構造式 ( 2 a ) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミドは構造式 ( 3 a ' ) に示す光配向性ポリイミドであった。第 2 ポリイミドのイミド化率はおよそ 50 % であった。

50

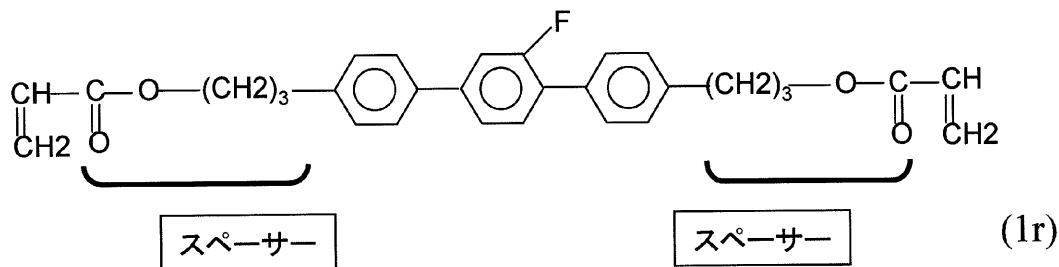
## 【 0 2 1 9 】

ここでは、ビニル系モノマーとして、構造式 ( 1 r ) に示すジアクリレートモノマーを添加した。

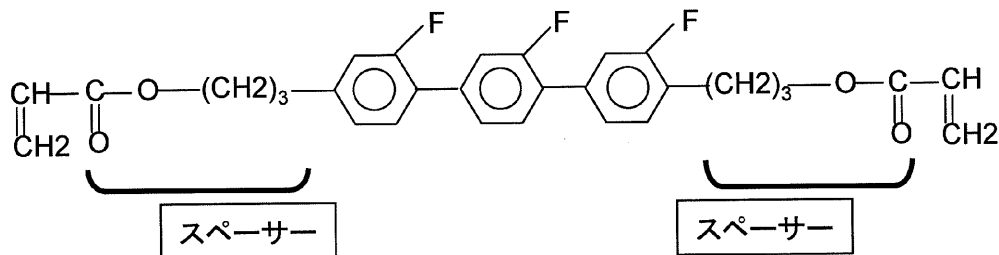
## 【 化 2 4 】



10



20



30

## 【 0 2 2 0 】

構造式 ( 1 r ) から理解されるように、このジアクリレートモノマーにはスペーサが付与されており、構造式 ( 1 a ) に示したモノマーよりも長いモノマーであった。

## 【 0 2 2 1 】

なお、ジアクリレートモノマーの濃度は配向膜材料に対して 1 0 w t % であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が 0、1 および 3 の 3 種類の配向膜材料を用意した。

## 【 0 2 2 2 】

次に、配向膜材料を画素電極上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布した後、第 1 加熱処理 ( 仮焼成 ) として 9 0 ° で 1 分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに第 2 加熱処理として 2 0 0 ° で 4 0 分間加熱した。これにより、画素電極上に第 1 配向膜が形成された。この第 1 配向膜にはポリビニル化合物は形成されなかった。

40

## 【 0 2 2 3 】

次に、第 1 配向膜の主面の法線方向に対して斜め 4 0 ° 方向から、ピーク波長 3 3 0 n m の P 偏光を 5 0 m J / c m ² 照射することにより、光配向処理を行った。このように光照射を行うとシナメート基が二量化反応を起こして、二量化サイトが形成された。同様に、上述した配向膜材料を塗布して対向電極上に第 2 配向膜を形成し、光配向処理を行った。

## 【 0 2 2 4 】

次に、第 1 配向膜および第 2 配向膜が対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が 9 0 ° となるようにアクティブマトリクス基板およ

50

び対向基板を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板と対向基板との間隔が  $4\ \mu\text{m}$  程度になるように固定した。

【0225】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板と対向基板との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は -3、複屈折率  $n$  が 0.085 であった。このようにして液晶パネルを作製した。表 9 に、モノマーあたりのフッ素基の数とプレチルト角との関係を示す。

【0226】

【表 9】

フッ素基の数	0	1	3
プレチルト角 (°)	88.8	88.9	88.8

10

【0227】

表 9 から理解されるように、フッ素基の数によらずプレチルト角は略一定である。これは、連結された  $\text{CH}_2$  基により、フッ素基が液晶配向に及ぼす影響が小さくなったためと考えられる。

【0228】

次に、作製した液晶パネルに対して、実施例 1 - 1 から 1 - 4 と同様に、室温で電圧  $\pm 10\text{V}$  を 50 時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表 10 に、その結果を示す。

20

【0229】

【表 10】

フッ素基の数	0	1	3
プレチルト角 (°)	88.8	88.9	88.8
チルト角変化量 (°)	0.21	0.21	0.21

【0230】

表 10 から理解されるように、構造式 (1r) に示したモノマーを添加した場合、フッ素基の有無によらず、通電によるチルト角変化量も大きかった。これは、構造式 (1r) に示したモノマーのスペーサ部分は構造式 (1a) に示したモノマーよりも長く、構造式 (1r) に示したモノマーでは、柔軟性の比較的高い  $\text{CH}_2$  基が複数連結しているためと考えられる。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は 99.5% 以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

30

【0231】

【実施例 2】

以下、図 2 および図 6 を参照して、実施例 2 の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例 2 の液晶表示装置も RTN モードで動作する。

【0232】

40

まず、第 1 絶縁基板 222 の主面の上に、図示しないが、TF T および TF T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 224 を形成した。同様に、第 2 絶縁基板 242 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 244 を形成した。

【0233】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 (2a) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミド p 2 は構造式 (3b') に示す垂直配向性ポリイミドであった。第 2 ポリイミド p 2 のイミド化率はおよそ 50% であった。ビニル系

50

モノマーとして、式(1a)に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して10wt%であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が2、4および6の3種類の配向膜材料を用意した。また、比較のために、フッ素基の数がゼロのモノマーの配向膜材料も用意した。

#### 【0234】

次に、配向膜材料を画素電極224上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第1加熱処理(仮焼成)として90で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第2加熱処理(本焼成)として200で40分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミク酸がイミド化して第1、第2ポリイミドp1、p2が形成されるとともにビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物pvが形成された。このようにして、画素電極224上に第1配向膜110が形成された。

#### 【0235】

その後、第1配向膜110にラビング処理を行った。同様に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極244上に第2配向膜120を形成し、ラビング処理を行った。

#### 【0236】

次に、第1配向膜110および第2配向膜120が互いに対向するとともに第1配向膜の配向処理方向と第2配向膜の配向処理方向とのなす角が90°となるようにアクティブマトリクス基板220および対向基板240を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板220と対向基板240との間隔が4μm程度になるように固定した。

#### 【0237】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板220と対向基板240との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は-3、複屈折率nが0.085であった。このようにして液晶パネルを作製した。表11に、ビニル系モノマーあたりのフッ素基の数とプレチルト角との関係を示す。

#### 【0238】

【表11】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角(°)	88.4	88.3	88.0	88.0

#### 【0239】

表11から理解されるように、フッ素基の数がゼロであるとプレチルト角は大きい、モノマーがフッ素基を有していると、プレチルト角は低下する。

#### 【0240】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧±10Vを50時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表12に、その結果を示す。

#### 【0241】

【表12】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角(°)	88.4	88.3	88.0	88.0
チルト角変化量(°)	0.11	0.03	0.02	0.02

#### 【0242】

表12から理解されるように、モノマーがフッ素基を有していることにより、チルト角変化量が抑制されている。これは、フッ素基に起因して、第1、第2配向膜110、120の表面に存在するビニル系モノマーまたはポリビニル化合物pvの密度が高くなり、ポリビニル化合物pvと液晶分子262との相互作用により、液晶分子262のチルト角変化が抑えられたと考えられる。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は99.5%以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

## 【 0 2 4 3 】

## [ 実施例 3 ]

以下、図 2 および図 6 を参照して、実施例 3 の配向膜および液晶表示装置を説明する。  
実施例 3 の液晶表示装置も R T N モードで動作する。

## 【 0 2 4 4 】

まず、第 1 絶縁基板 2 2 2 の主面の上に、図示しないが、T F T および T F T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 2 2 4 を形成した。同様に、第 2 絶縁基板 2 4 2 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 2 4 4 を形成した。

## 【 0 2 4 5 】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。配向膜材料は、第 1 ポリイミド p 1 の前駆体と、第 2 ポリイミド p 2 およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第 1 ポリイミド p 1 の前駆体は構造式 ( 2 a ) に示すポリアミック酸であり、第 2 ポリイミド p 2 は構造式 ( 3 b ' ) に示す垂直配向性ポリイミドであった。第 2 ポリイミド p 2 のイミド化率はおよそ 5 0 % であった。ビニル系モノマーとして、式 ( 1 a ) に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して 1 0 w t % であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が 2、4 および 6 の 3 種類の配向膜材料を用意した。また、比較のために、フッ素基の数がゼロのモノマーの配向膜材料も用意した。

## 【 0 2 4 6 】

次に、配向膜材料を画素電極 2 2 4 上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第 1 加熱処理 ( 仮焼成 ) として 9 0 ° で 1 分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第 2 加熱処理 ( 本焼成 ) として 2 0 0 ° で 4 0 分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化して第 1、第 2 ポリイミド p 1、p 2 が形成されるとともにビニル系モノマーが重合してポリビニル化合物 p v が形成された。このようにして、画素電極 2 2 4 上に第 1 配向膜 1 1 0 が形成された。

## 【 0 2 4 7 】

その後、第 1 配向膜 1 1 0 に、イオンビームを照射することによって配向処理を行った。同様に、上述した配向膜材料を塗布して、対向電極 2 4 4 上に第 2 配向膜 1 2 0 を形成し、イオンビームを照射することによって配向処理を行った。

## 【 0 2 4 8 】

次に、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 が互いに対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が 9 0 ° となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間隔が 4 μ m 程度になるように固定した。

## 【 0 2 4 9 】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性  $\epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp}$  は - 3、複屈折率  $n$  が 0 . 0 8 5 であった。このようにして液晶パネルを作製した。表 1 3 に、モノマーあたりのフッ素基の数とプレチルト角との関係を示す。

## 【 0 2 5 0 】

## 【 表 1 3 】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角 (°)	86.9	86.6	86.5	86.5

## 【 0 2 5 1 】

表 1 3 から理解されるように、モノマーがフッ素基を有していると、プレチルト角は低下する。なお、ラビング処理を行った場合と比べてプレチルト角が小さいのは、イオンビームの照射により、垂直配向性ポリイミドの一部が分解したためと考えられる。

## 【 0 2 5 2 】

次に、作製した液晶パネルに対して、室温で電圧 $\pm 10\text{ V}$ を50時間印加し続ける通電試験を行った後でチルト角変化量を測定した。表14に、その結果を示す。

## 【 0 2 5 3 】

## 【表14】

フッ素基の数	0	2	4	6
プレチルト角(°)	86.9	86.6	86.5	86.5
チルト角変化量(°)	0.16	0.06	0.04	0.04

10

## 【 0 2 5 4 】

表14から理解されるように、モノマーがフッ素基を有していると、チルト角変化量が抑制される。これは、フッ素基により、第1、第2配向膜110、120の表面に存在するビニル系モノマーまたはポリビニル化合物p vの密度が高くなり、ポリビニル化合物p vと液晶分子262との相互作用により、液晶分子262のチルト角変化が抑えられたと考えられる。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は99.5%以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

## 【 0 2 5 5 】

## [ 実施例4 ]

以下、図2および図7を参照して、実施例4の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例4の液晶表示装置もRTNモードで動作する。

20

## 【 0 2 5 6 】

まず、第1絶縁基板222の主面の上に、図示しないが、TF TおよびTF Tに接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極224を形成した。同様に、第2絶縁基板242の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極244を形成した。

## 【 0 2 5 7 】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第1ポリイミドp 1の前駆体と、第2ポリイミドp 2およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第1ポリイミドp 1の前駆体は構造式(2a)に示すポリアミック酸であり、第2ポリイミドp 2は構造式(3a')に示す光配向性ポリイミドであった。第2ポリイミドp 2のイミド化率はおよそ50%であった。ビニル系モノマーとして、式(1a)に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して10wt%であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が4のジメタクリレートモノマーを用いた。

30

## 【 0 2 5 8 】

次に、配向膜材料を画素電極224上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第1加熱処理(仮焼成)として90℃で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第2加熱処理(本焼成)として200℃で40分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化し、第1ポリイミドp 1を含む第1配向層112および第2ポリイミドp 2を含む第2配向層114が形成された。

40

## 【 0 2 5 9 】

その後、第1配向膜110のうち各画素の半分に対応する領域に対して、方位角0°および第1配向膜110の主面の法線方向に対して斜め40°方向から、ピーク波長330nmのP偏光を50mJ/cm<sup>2</sup>照射した。光照射を行うとシンナメート基が二量化反応を起こして、二量化サイトが形成された。次いで、第1配向膜110の各画素の別の半分に対応する領域に対して、方位角180°および第1配向膜110の主面の法線方向に対して斜め40°方向から、ピーク波長330nmのP偏光を50mJ/cm<sup>2</sup>照射した。このようにして光配向処理を行い、配向処理方向の異なる領域を形成した。

## 【 0 2 6 0 】

50

また、同様に、上述した配向膜材料を対向電極 2 4 4 上に塗布し、90°で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに200°で40分間加熱した。第1ポリイミド p 1 が形成されるとともにジメタクリレートが重合してポリビニル化合物 p v が形成された。このようにして、対向電極 2 4 4 上に第2配向膜 1 2 0 が形成された。その後、第2配向膜 1 2 0 の各画素に対して、第2配向膜 1 2 0 の主面の法線方向に対して斜め40°方向から、ピーク波長330 nmのP偏光を50 mJ / cm<sup>2</sup>照射した。このようにして光配向処理を行った。なお、第1、第2配向膜 1 1 0、1 2 0 を分析したところ、式(1 a)に示すジメタクリレートは重合しており、配向膜表面にもポリビニル化合物 p v は存在していた。

#### 【0261】

次に、第1配向膜 1 1 0 および第2配向膜 1 2 0 が互いに対向するとともに第1配向膜の配向処理方向と第2配向膜の配向処理方向とのなす角が90°となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間隔が4 μm程度になるように固定した。

#### 【0262】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は - 3、複屈折率 n が 0.085 であった。

#### 【0263】

図7に、実施例4の第1、第2配向膜 1 1 0、1 2 0 の配向処理方向を示す。上述したように、第1配向膜 1 1 0 の配向処理方向 P D 1、P D 2 と第2配向膜 1 2 0 の配向処理方向 P D 3 とのなす角が90°となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせており、液晶分子 2 6 2 のねじれ角は90°であった。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は99.5%以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

#### 【0264】

##### [ 実施例 5 ]

以下、図2および図8を参照して、実施例5の配向膜および液晶表示装置を説明する。実施例5の液晶表示装置も R T N モードで動作する。

#### 【0265】

まず、第1絶縁基板 2 2 2 の主面の上に、図示しないが、T F T および T F T に接続された配線および絶縁層等を形成し、それらの上に画素電極 2 2 4 を形成した。同様に、第2絶縁基板 2 4 2 の主面の上に、図示しないが、カラーフィルタを有する着色層および絶縁層等を形成し、それらの上に対向電極 2 4 4 を形成した。

#### 【0266】

次に、垂直配向型の配向膜材料を用意した。この配向膜材料は、光配向膜用の配向膜材料であった。配向膜材料は、第1ポリイミド p 1 の前駆体と、第2ポリイミド p 2 およびその前駆体とを溶媒に溶解させた後に、ビニル系モノマーを添加することによって形成された。第1ポリイミド p 1 の前駆体は構造式(2 a)に示すポリアミック酸であり、第2ポリイミド p 2 は構造式(3 a')に示す光配向性ポリイミドであった。第2ポリイミド p 2 のイミド化率はおよそ50%であった。ビニル系モノマーとして、式(1 a)に示すジメタクリレートモノマーを添加し、その濃度は配向膜材料に対して10 wt %であった。ここでは、モノマーあたりのフッ素基の数が0、2、4および6の4種類の配向膜材料を用意した。

#### 【0267】

次に、配向膜材料を画素電極 2 2 4 上に印刷法、インクジェット法またはスピンコート法で塗布し、第1加熱処理(仮焼成)として90°で1分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに、第2加熱処理(本焼成)として200°で40分間加熱した。このような加熱処理により、ポリアミック酸がイミド化し、第1ポリイミド p 1 を含む第1配向層 1 1 2 および第2ポリイミド p 2 を含む第2配向層 1 1 4 が形成された。このようにして、画

10

20

30

40

50

素電極 2 2 4 上に第 1 配向膜 1 1 0 が形成された。

【 0 2 6 8 】

その後、第 1 配向膜 1 1 0 のうち各画素の半分に対応する領域に対して、方位角  $0^\circ$  および第 1 配向膜 1 1 0 の主面の法線方向に対して斜め  $40^\circ$  方向から、ピーク波長  $330\text{ nm}$  の P 偏光を  $50\text{ mJ/cm}^2$  照射した。光照射を行うとシンナメート基が二量化反応を起こして、二量化サイトが形成された。次いで、第 1 配向膜 1 1 0 の各画素の別の半分に対応する領域に対して、方位角  $180^\circ$  および第 1 配向膜 1 1 0 の主面の法線方向に対して斜め  $40^\circ$  方向から、ピーク波長  $330\text{ nm}$  の P 偏光を  $50\text{ mJ/cm}^2$  照射した。このようにして光配向処理を行い、配向処理方向の異なる領域を形成した。

【 0 2 6 9 】

また、第 1 配向膜 1 1 0 と同様に、上述した配向膜材料を対向電極 2 4 4 上に塗布し、 $90^\circ$  で 1 分間加熱して溶媒をある程度除去し、さらに  $200^\circ$  で 40 分間加熱した。これにより、ポリアミック酸がイミド化し、第 1 ポリイミド p 1 を含む第 1 配向層 1 2 2 および第 2 ポリイミド p 2 を含む第 2 配向層 1 2 4 が形成された。このようにして、対向電極 2 4 4 上に第 2 配向膜 1 2 0 が形成された。

【 0 2 7 0 】

その後、第 2 配向膜 1 2 0 において各画素の半分に対応する領域に対して、方位角  $90^\circ$  および第 2 配向膜 1 2 0 の主面の法線方向に対して斜め  $40^\circ$  方向から、ピーク波長  $330\text{ nm}$  の P 偏光を  $50\text{ mJ/cm}^2$  照射した。光照射を行うとシンナメート基が二量化反応を起こして、二量化サイトが形成された。次いで、第 2 配向膜 1 2 0 において各画素の別の半分に対応する領域に対して、方位角  $270^\circ$  および第 2 配向膜 1 2 0 の主面の法線方向に対して斜め  $40^\circ$  方向から、ピーク波長  $330\text{ nm}$  の P 偏光を  $50\text{ mJ/cm}^2$  照射した。このようにして光配向処理を行い、配向処理方向の異なる領域を形成した。なお、第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 を分析したところ、式 ( 1 a ) に示すジメタクリレートは重合しており、配向膜表面にもポリビニル化合物 p v は存在していた。

【 0 2 7 1 】

次に、第 1 配向膜 1 1 0 および第 2 配向膜 1 2 0 が互いに対向するとともに第 1 配向膜の配向処理方向と第 2 配向膜の配向処理方向とのなす角が  $90^\circ$  となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせて、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間隔が  $4\text{ }\mu\text{m}$  程度になるように固定した。

【 0 2 7 2 】

次に、負の誘電率異方性を有するネマティック液晶材料を用意し、アクティブマトリクス基板 2 2 0 と対向基板 2 4 0 との間に付与した。液晶材料の誘電率異方性は - 3、複屈折率  $n$  が  $0.085$  であった。

【 0 2 7 3 】

図 8 に、実施例 5 の第 1、第 2 配向膜 1 1 0、1 2 0 の配向処理方向を示す。上述したように、第 1 配向膜 1 1 0 の配向処理方向 P D 1、P D 2 と第 2 配向膜 1 2 0 の配向処理方向 P D 3、P D 4 とのなす角が  $90^\circ$  となるようにアクティブマトリクス基板 2 2 0 および対向基板 2 4 0 を貼り合わせており、液晶分子 2 6 2 のねじれ角は  $90^\circ$  であった。なお、通電試験終了後に測定した電圧保持率は  $99.5\%$  以上であったことから、通電が充分行われていることが確認された。

【 0 2 7 4 】

なお、参考のために、本願の基礎出願である特願 2 0 0 8 - 2 7 1 3 7 6 号の開示内容を本明細書に援用する。

【産業上の利用可能性】

【 0 2 7 5 】

本発明による配向膜は、プレチルト角の変化に起因する焼き付きを抑制することができる。また、本発明による液晶表示装置は簡便に製造され得る。例えば、アクティブマトリクス基板と対向基板を貼り合わせた後に重合を行う必要が無く、製造上の自由度を増大させることができる。

10

20

30

40

50

## 【符号の説明】

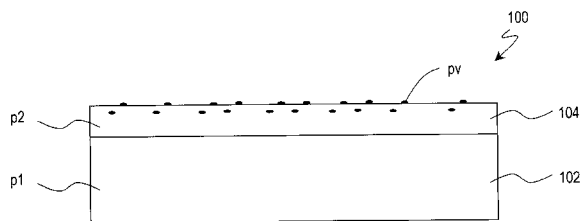
## 【 0 2 7 6 】

- 1 0 0 配向膜  
 p 1 第 1 ポリイミド  
 p 2 第 2 ポリイミド  
 p v ポリビニル化合物  
 1 0 2 第 1 配向層  
 1 0 4 第 2 配向層  
 1 1 0 第 1 配向膜  
 1 1 2 第 1 配向層  
 1 1 4 第 2 配向層  
 1 2 0 第 2 配向膜  
 1 2 2 第 1 配向層  
 1 2 4 第 2 配向層  
 2 0 0 液晶表示装置  
 2 2 0 アクティブマトリクス基板  
 2 2 2 第 1 絶縁基板  
 2 2 4 画素電極  
 2 4 0 対向基板  
 2 4 2 第 2 絶縁基板  
 2 4 4 対向電極  
 2 6 0 液晶層  
 2 6 2 液晶分子  
 3 0 0 液晶パネル

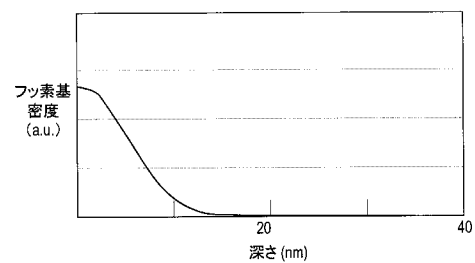
10

20

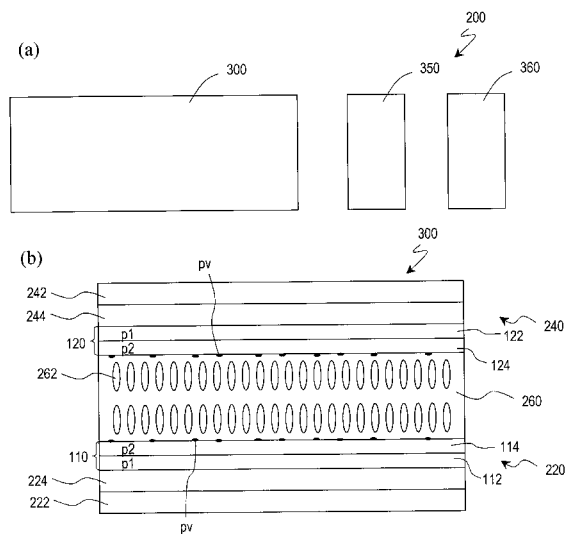
## 【 図 1 】



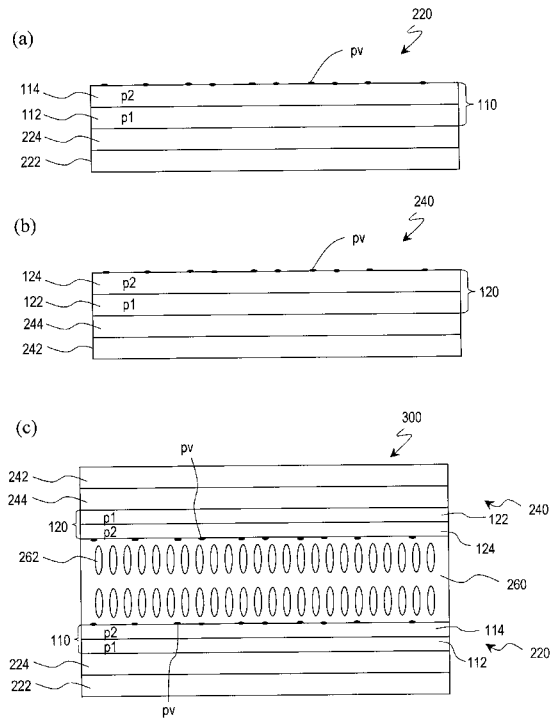
## 【 図 3 】



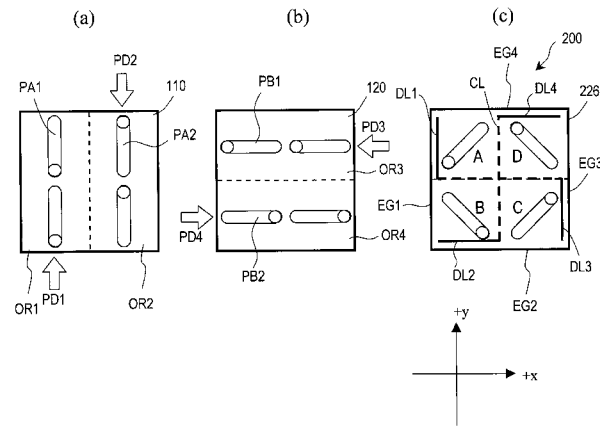
## 【 図 2 】



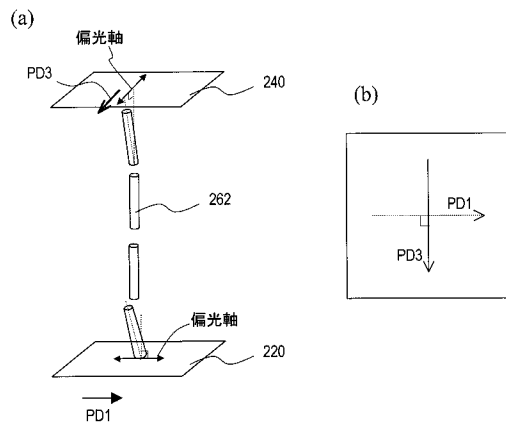
【図 4】



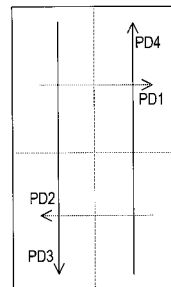
【図 5】



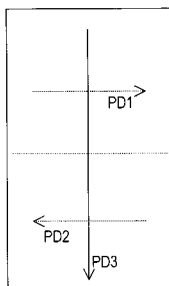
【図 6】



【図 8】



【図 7】



## 【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2009/002862
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> G02F1/1337(2006.01)i, C08F2/44(2006.01)i, C08F20/00(2006.01)i, C08G73/10(2006.01)i  According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G02F1/1337, C08F2/44, C08F20/00, C08G73/10  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2009 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2009 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2009  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA/REGISTRY(STN)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A X	JP 2007-304509 A (JSR Corp.), 22 November, 2007 (22.11.07), Claim 1; Par. Nos. [0052], [0056] to [0058], [0083], [0084] & KR 10-2007-0110791 A & CN 101075042 A	1-22, 24, 25 23, 26
A	JP 6-202118 A (Chisso Corp.), 22 July, 1994 (22.07.94), Par. Nos. [0019] to [0022] (Family: none)	1-26
A	JP 9-185066 A (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.), 15 July, 1997 (15.07.97), Par. Nos. [0041], [0048] (Family: none)	1-26
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 14 September, 2009 (14.09.09)		Date of mailing of the international search report 29 September, 2009 (29.09.09)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/002862

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 7-101904 A (Seiko Epson Corp.), 18 April, 1995 (18.04.95), Claims 1, 2 (Family: none)	1-26
A	JP 2003-261511 A (Merck Patent GmbH), 19 September, 2003 (19.09.03), Par. Nos. [0001] to [0014], [0063], [0067] & US 2003/0160210 A1 & DE 10257711 A	1-26
P, A	JP 2009-132718 A (Merck Patent GmbH), 16 June, 2009 (16.06.09), Claims 1, 17; Par. Nos. [0244], [0249] & EP 2065361 A2 & US 2009-141215 A1 & KR 2009-0056854 A	1-26

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/002862									
<b>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</b> Int.Cl. G02F1/1337(2006.01)i, C08F2/44(2006.01)i, C08F20/00(2006.01)i, C08G73/10(2006.01)i											
<b>B. 調査を行った分野</b> 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. G02F1/1337, C08F2/44, C08F20/00, C08G73/10											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2009年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2009年	日本国実用新案登録公報	1996-2009年	日本国登録実用新案公報	1994-2009年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2009年										
日本国実用新案登録公報	1996-2009年										
日本国登録実用新案公報	1994-2009年										
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語） CA/REGISTRY (STN)											
<b>C. 関連すると認められる文献</b>											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A X	JP 2007-304509 A（JSR株式会社）2007.11.22, 請求項1、段落【0052】、【0056】－【0058】、【0083】、【0084】 & KR 10-2007-0110791 A & CN 101075042 A	1-22, 24, 25 23, 26									
A	JP 6-202118 A（チッソ株式会社）1994.07.22, 段落【0019】－【0022】 （ファミリーなし）	1-26									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
<table border="0"> <tr> <td> <b>* 引用文献のカテゴリー</b>            「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの            「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの            「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）            「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献            「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願         </td> <td>           の日の後に公表された文献            「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの            「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの            「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの            「&amp;」同一パテントファミリー文献         </td> </tr> </table>				<b>* 引用文献のカテゴリー</b> 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献						
<b>* 引用文献のカテゴリー</b> 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献										
国際調査を完了した日 14.09.2009		国際調査報告の発送日 29.09.2009									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/JP） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 磯野 光司	2L 3411								
		電話番号 03-3581-1101 内線	3293								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 2 8 6 2
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 9-185066 A (日本合成ゴム株式会社) 1997. 07. 15, 段落【0041】、【0048】 (ファミリーなし)	1-26
A	JP 7-101904 A (セイコーエプソン株式会社) 1995. 04. 18, 請求項1, 2 (ファミリーなし)	1-26
A	JP 2003-261511 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル ハフツング) 2003. 09. 19, 段落【0001】 - 【0014】、【0063】、【0067】 & US 2003/0160210 A1 & DE 10257711 A	1-26
P, A	JP 2009-132718 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル ハフツング) 2009. 06. 16, 請求項1, 17、段落【0244】、【0249】 & EP 2065361 A2 & US 2009-141215 A1 & KR 2009-0056854 A	1-26

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 仲西 洋平

大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

Fターム(参考) 2H090 HB08Y HC05 HC06 HC08 KA05 KA07 LA04 LA15 MA01 MA02

MA11 MA15 MB12

4J011 AA05 PA97 PB40 PC08 QA12

4J026 AB34 BA28 BB01 DB06 DB09 DB32 DB36 FA05 FA09 GA01

GA02 GA07 GA08

4J043 PA19 PC085 PC145 QB15 QB26 QB31 RA35 SA06 SB01 TA14

TA22 TB01 UA022 UA032 UA121 UA122 UA131 UA132 UA251 UA252

UA261 UA262 UB011 UB012 UB021 UB121 UB122 UB401 UB402 VA021

VA022 YA06 YB19 ZA09 ZB23

4J100 AL66P BB07P BC44P CA23 DA66 HG23 JA39

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	具有取向膜，取向膜材料和取向膜的液晶显示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2010047011A1</a>	公开(公告)日	2012-03-15
申请号	JP2010534653	申请日	2009-06-23
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	水崎真伸 仲西洋平		
发明人	水崎 真伸 仲西 洋平		
IPC分类号	G02F1/1337 C08F2/44 C08F20/00 C08G73/10 C08F283/04		
CPC分类号	C08L79/08 C08F222/1006 C08G73/1039 C08G73/1046 C08G73/105 C08G73/1067 C08G73/1075 C08G73/1078 C08L2205/02 G02F1/13363 G02F1/133723 G02F1/1393 G02F2001/133742 Y10T428/31721		
FI分类号	G02F1/1337.525 C08F2/44.C C08F20/00 C08G73/10 C08F283/04		
F-TERM分类号	2H090/HB08Y 2H090/HC05 2H090/HC06 2H090/HC08 2H090/KA05 2H090/KA07 2H090/LA04 2H090/LA15 2H090/MA01 2H090/MA02 2H090/MA11 2H090/MA15 2H090/MB12 4J011/AA05 4J011/PA97 4J011/PB40 4J011/PC08 4J011/QA12 4J026/AB34 4J026/BA28 4J026/BB01 4J026/DB06 4J026/DB09 4J026/DB32 4J026/DB36 4J026/FA05 4J026/FA09 4J026/GA01 4J026/GA02 4J026/GA07 4J026/GA08 4J043/PA19 4J043/PC085 4J043/PC145 4J043/QB15 4J043/QB26 4J043/QB31 4J043/RA35 4J043/SA06 4J043/SB01 4J043/TA14 4J043/TA22 4J043/TB01 4J043/UA022 4J043/UA032 4J043/UA121 4J043/UA122 4J043/UA131 4J043/UA132 4J043/UA251 4J043/UA252 4J043/UA261 4J043/UA262 4J043/UB011 4J043/UB012 4J043/UB021 4J043/UB121 4J043/UB122 4J043/UB401 4J043/UB402 4J043/VA021 4J043/VA022 4J043/YA06 4J043/YB19 4J043/ZA09 4J043/ZB23 4J100/AL66P 4J100/BB07P 4J100/BC44P 4J100/CA23 4J100/DA66 4J100/HG23 4J100/JA39		
代理人(译)	奥田诚治 三宅明子		
优先权	2008271376 2008-10-21 JP		
其他公开文献	JP5198577B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

根据本发明的取向膜材料包括：第一聚酰亚胺 ( p1 ) 的前体；和第一聚酰亚胺的前体。第二聚酰亚胺 ( p2 ) 及其前体；和乙烯基类单体。乙烯基类单体由通式 ( 1 ) 表示。P1-A1- ( Z1-A2 ) n-P2 ( 通式 ( 1 ) 中，P1和P2独立地为丙烯酸酯，甲基丙烯酸酯，丙烯酰胺或甲基丙烯酰胺；A1和A2独立地表示1,4-亚苯基，1,4-环己烷或2,5-噻吩或萘-2,6-二基或蒽-2,7-二基；A1和A2中的至少一个被取代。至少一个氟基；并且Z 1为-COO-基，-OCO-基，-O-基，-CONH-基或单键，其中n为0或1 ) 。

【图1】

